



ارائه شده توسط :

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معابر

## فیلترهای میکروالکترومکانیکی HF با Q بالا

### چکیده

فیلترهای فرکانس رابط میکروالکترومکانیکی سازگار با IC که در تشدید کننده های مجتمع با Q در هزاران مورد مورد استفاده قرار می گیرد تا به فیلتر Q در صد دست یابد با استفاده از فناوری ماشین کاری میکروونی<sup>۱</sup> با سطح پلی سیلیکان نشان داده شده است. این فیلترها از دو تشدید کننده میکرومکانیکی باریکه دوسر گیردار تشکیل شده است که با فنر مکانیکی حالت ارجاعی نرم تزویج شده است. فرکانس مرکزی یک فیلتر توسط فرکانس تشدید تشدید کننده های تشکیل دهنده تعیین می شود در حالیکه پهنهای باند توسط ابعاد فنر تزویج و جایگاهش بین تشدید کننده ها تعیین می گردد. تزویج ربع طول موج بر این ریز مقیاس مورد نیاز است تا اثر بارگذاری جرم ناشی از تشدید کننده ها مشابه و ابعاد تزویجگر را کاهش دهد. علاوه محدودیت های ناشی از طرح ربع طول موج ، طیفی از درصد پهنهای باند با در نظر گرفتن مزیت موقعیت های اتصال فنر با سرعت پایین همچنان قابل دست یابی است. یک طرح کامل ارائه می شود که در آن شباهت های الکترومکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد تا دستگاه مکانیکی را از طریق مدارهای الکتریکی معادل مدل سازی کند. فرکانس های مرکزی فیلتر حدود ۸ مگاهرتز با Q از ۴۰ تا ۴۵۰ (یعنی، درصد پهنهای باند از ۰,۲۳ تا ۰,۲۵٪)، تلفات جای گزینی مرتبط کمتر از ۲ dB و محدوده پویایی عاری از تداخلگر<sup>۲</sup> حدود ۷۸ dB با استفاده از طرح های سرعت پایین با مقاومت های پایان<sup>۳</sup> ورودی و خروجی با ترتیب ۱۲ کیلواهرم نشان داده شده است.

واژگان کلیدی: میان گذر، فیلتر، Q، بالا، HF، تلفات جای گزینی، MEMS، میکرومکانیکی.

### مقدمه

<sup>1</sup> Micromachining

<sup>2</sup> Spurious-free dynamic ranges

<sup>3</sup> Termination resistance

اکثر فیلترهای میان گذر Q بالا که در مراحل فرستنده گیرنده هترودین<sup>۴</sup> فرکانس رادیویی (RF) و فرکانس میانه (IF) مورد استفاده قرار می گیرند با استفاده از مولفه های تشدید مکانیکی خارج از تراشه<sup>۵</sup> مانند دستگاه های فیلترهای کریستال و موج آکوستیک سطح (SAW) درک می شوند. به دلیل ضریب کیفیت Q بالاتر، چنین فناوری هایی در مقایسه با فیلترهایی که از فناوری ترانزیستور، تلفات جای گزینی، درصد پهنهای باند و رد قابل دسترسی استفاده می کنند، بهتر عمل می کنند (۱)-(۴). با این وجود، به دلیل اینکه یک قطعه خارج تراشه است، این دستگاه های مکانیکی باید با الکترونیک های مجتمع در سطح برد ارتباط داشته باشند و این شامل تنگنای مهمی برای کوچک سازی و عملکرد گیرنده فرستنده می سوپرهترودین می باشد. به این دلیل، تلاش های اخیر برای دستیابی به گیرنده فرستنده می تک تراشه برای برنامه های کاربردی پیج و تلفن همراه از معماری های جایگزین استفاده کرده است (مانند تبدیل مستقیم (۵)، پهنهای باند IF (۶)، یا نمونه برداری مستقیم (۷)) و از سوپرهترودین بهره نبرده است و تا کنون عملکرد کلی مناسبی نداشته است.

فناوری ماشین کاری میکرونی که تشدید کننده های میکرومکانیکی با تراشه Q بالا را ممکن می سازد (۸)، اکنون (۹) روشی برای کوچک سازی و تزویج فیلترهای منتخب به همراه ترانزیستورها را پیشنهاد کرده است و هدف این است که شاید روزی فرستنده گیرنده میکرونی کوچک شده را مقدور سازد. با Q بیش از ۸۰۰۰ (۱۰) در خلا و ضرایب دمای فرکانس مرکزی در طیف ppm/C-10 (چندبرابر کمتر از تکنیک صفر<sup>۶</sup>) (۱۱)، تشدید کننده های میکرومکانیکی سیلیکونی پلی کریستال (که مخفف آن "resonators" است) می توانند به طور بالقوه مانند جایگزین کوچک شده برای کریستال هایی در مجموعه ای از برنامه های کاربردی فیلترسازی و نوسانگر Q بالا (۱۰) عمل کنند (۱۲)، (۱۳). پیش تر، MF (یعنی kHz ۴۵۵) سه نمونه اولیه تشدید کننده از چنین فیلترهایی نشان داده شده است (۱۴)، (۲۰). با این وجود، برای استفاده در ارتباطات، فرکانس های بالاتر باید در دسترس باشد. این کار به بسط فرکانسی طیف فرکانس بالا (IF) می رسد و در مورد طرح، ساخت، و عملکرد نمونه اولیه، پردازش IC صفحه ای، فیلترهای میان گذر مکانیکی  $\mu$  با فرکانس های مرکزی در حول ۸ مگاهرتز، درصد پهنهای باند به ترتیب ۰.۲٪ با

<sup>4</sup> Heterodyne

<sup>5</sup> Off-chip

<sup>6</sup> Nulling techniques

تلفات جایگزینی مربوطه کمتر از  $\text{dB}2$ ، رد باندتوقف بیشتر از  $\text{dB}35$  و محدوده پویایی عاری از تداخلگر (SFDR) برای تن های اولیه ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوهرتز دور از  $\text{dB}78$  را گزارش می دهد. با آغاز توصیف کیفی ساختار میکرومکانیکی و عملکرد آن در بخش II، این مقاله جزئیات طرح تشدید کننده میکرومکانیکی را در بخش III ادامه می دهد و سپس با توصیف مرحله به مرحله طرح فیلتر میکرومکانیکی در بخش IV پیش می رود. ساخت، مشخصات طرح و نتایج بررسی عملکرد در بخش V و VI ارائه شده است که طرح هایی در مورد طیف فرکانس پایان از فیلترهای VII مکانیکی در بخش VII را به همراه دارد.

III.

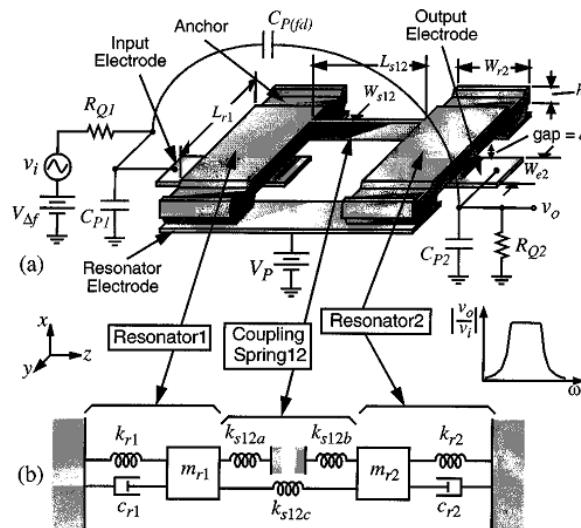
### توصیف کیفی ساختار و عملیات فیلتر

شکل ۱ طرح فیلتر دو تشدید کننده را به همراه بایاس مناسب، تحریک و مدار حسگر نشان می دهد. همانطور که نشان داده شده است، فیلتر شامل دو تشدید کننده باریکه دوسرگیر دار مکانیکی<sup>6</sup> است که به صورت مکانیکی با باریکه حالت ارجاعی تزویج شده است، که همه بالای زیرساخت A1300 معلق هستند. نوارهای رسانا ناحیه مرکزی هر تشدید کننده را مشخص می کند و به عنوان الکترود مبدل خازنی عمل می کند که ارتعاش تشدید کننده را در جهتی عمود بر زیرساخت القا می کند. فاصله تشدید کننده به الکترود برای A1300 هدف قرار می گیرد.

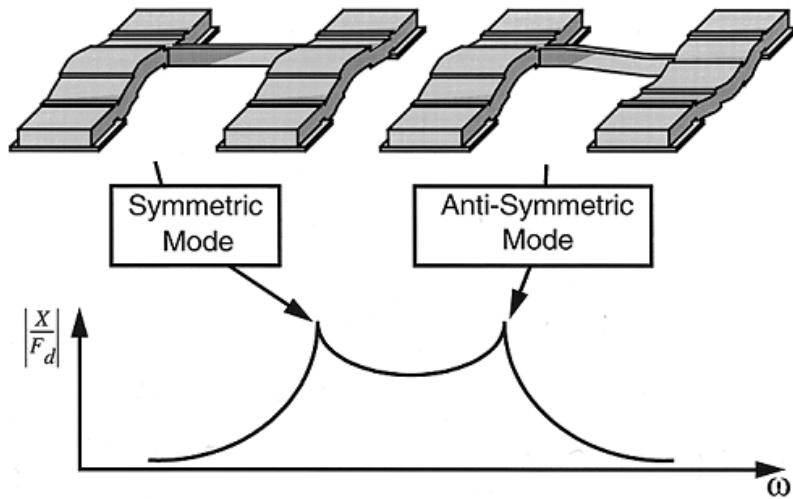
شکل ۱(ب) به وضوح فیلتر واقعی را برابر با مدار مکانیکی قرار می دهد که در آن هر تشدید کننده توسط سیستم ضربه گیر جرم فنر<sup>7</sup> ارائه می شود در حالیکه باریکه تزویجگر برابر با شبکه ای از فنرهای مکانیکی است. چنین سیستم دو تشدید کننده ای، دو حالت تشدید مکانیکی را با فرکانس کاملا بسته نشان می دهد که باند عبور فیلتر را تعريف می کند. فرکانس مرکزی فیلتر عمدتاً توسط فرکانس های تشدید کننده مشمول تعیین می شود در حالیکه فضای گیری بین حالت ها (یعنی پهنهای باند) اساساً توسط سختی فنر تزویجگر تعیین می گردد. همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است، هر پیک حالت منطبق با شکل حالت فیزیکی و مجزا است: در حالت فرکانس پایین، هر دو تشدید کننده در فاز ارتعاش دارند و در حالت فرکانس بالاتر، تشدید کننده ها ۱۸۰ درجه خارج از فاز هستند.

<sup>7</sup> Mass-spring-damper system

همانطور که توصیف خواهد شد، مقاومت پایان انتخابی  $R_{Qn}$  برای صاف کردن باند عبور دندانه دار مورد استفاده قرار می گیرد که در شکل ۲ نشان داده شده است تا آنچه که در شکل ۱ نشان داده شده بdst آید.



شکل ۱. (الف) طرح پرسپکتیو از فیلتر مکانیکی  $\Pi$  دو تشدیدکننده، به همراه مدار حسگر، تحریک و بایاس ترجیهی.  
عناصر مهم به رنگ خاکستری نشان داده شده است. (ب) مدار مکانیکی معادل.



شکل ۲. شکل های حالات فیلتر و انطباق شان برای پیک های خاص در مشخصات فرکانس بی پایان.

برای عملیاتی کردن این فیلتر، یک  $V_P$  بایاس dc به ساختار فیلتر معلق اعمال می شود و یک ولتاژ ورودی ac  $v_i$  در مقاومت  $R_{Q1}$  به الکترود ورودی به کار گرفته می شود (الکترود ۱)، همانطور که در شکل ۱ (الف) نشان داده

شده است. کاربرد این ورودی یک نیروی الکترواستاتیک جهت دار- $x$  بین الکترود ۱ و تشدیدکننده رسانایی ایجاد می کند که ارتعاش جهت دار- $x$  از تشدیدکننده ورودی را القا می کند زمانی که فرکانس ولتاژ ورودی از میان گذر فیلتر مکانیکی نشات می گیرد. این انرژی ارتعاشی توسط فنر تزویجگر به تشدیدکننده بیرونی فرستاده می شود و منجر می شود که آن هم مرتعش گردد. ارتعاش تشدیدکننده خروجی یک بایاس  $dc$ ، خازن زمان متغیر بین تشدیدکننده رسانا و الکترود بیرونی ایجاد می کند که جریان خروجی را به صورت زیر منبع قرار می دهد

$$i_{x2} = V_{Pn} \frac{\partial C_2}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} \quad (1)$$

که  $x$  جابجایی عمودی،  $\partial C_2 / \partial x$  با  $V_n$  برابر با ولتاژ  $dc$  بر الکترود  $n$  است و  $V_{Pn} = V_P - V_n$  تغییر در ظرفیت تشدیدکننده به الکترود در هر واحد جابجایی در پرت ۲ است. جریان  $i_{x2}$  به سمت مقاومت  $R_{Q2}$  جهت داده می شود که جریان را به همراه  $R_{Q1}$  به ولتاژ خروجی  $v_n$  تبدیل می کند، و امپدانس نهایی مناسب فراهم می کند که میان گذر دندانه دار در شکل ۲ را هموار می کند.

در واقع، این دستگاه سیگنال ورودی الکتریکی را دریافت می کند، آن را به سیگنال مکانیکی تبدیل می کند، در دامنه‌ی مکانیکی آن را پردازش می کند، سپس سیگنال حاصل را به سیگنال خروجی الکتریکی تبدیل می کند که برای پردازش بیشتر توسط مراحل الکتریکی متعاقب آمده می شود.

### تشدیدکننده‌های میکرومکانیکی HF

از آنجاییکه فرکانس مرکزی فیلتر مکانیکی داده شده عمدتاً توسط فرکانس‌های تشدید تشدیدکننده هایش تعیین می شود، طرح تشدیدکننده مکانیکی دقیق برای اجرای موقیت آمیز فیلتر اجباری است. طرح تشدیدکننده  $M$  انتخابی نه تنها باید بتواند به فرکانس مورد نیاز دسترسی داشته باشد بلکه باید خطی بودن کافی و قابلیت تنظیم با  $Q$  کافی را در نظر گیرد.

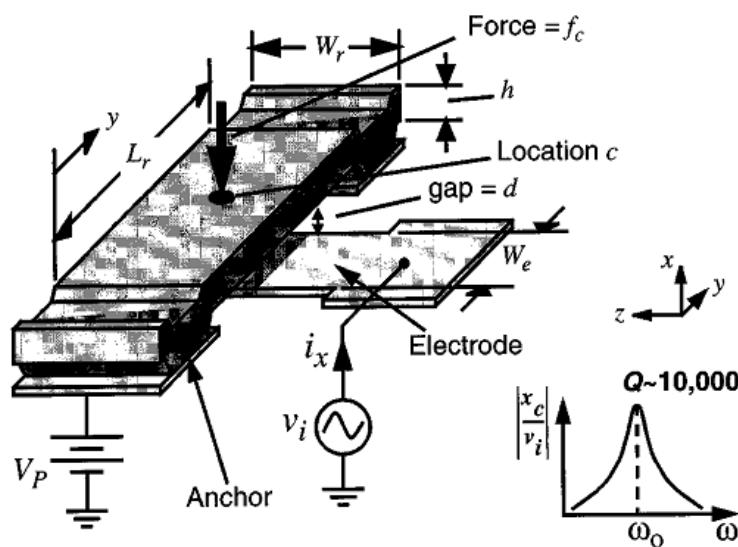
برای بسیاری از برنامه‌های کاربردی حسگر، مانند شتاب سنج (۱۵) یا ژیروسکوپ (۱۶)، هرچه فرکانس تشدید ساختار مکانیکی بیشتر باشد، حساسیت دستگاه بهتر می شود. بنابراین، اکثریت دستگاه‌های مکانیکی میکرومашینی

قبلی که هدفشنان برنامه های کاربردی حسگر هستند، به گونه ای طراحی شده اند که در فرکانس های پایین تر زیر ۱۰۰ کیلوهرتز عمل کنند. طرح هایی با طول زیاد فنر و جرم بالا برای این برنامه ها مناسب هستند و تکنیک های که خطی بودن و دامنه جابجایی را گسترش می دهند مانند ترادیسنسه های خازنی شانه ای<sup>۸</sup> و تعليق باريکه های فشرده<sup>۹</sup> (۹) اغلب مورد استفاده قرار می گيرند.

با اين حال، چنین طرح هایی برای برنامه ها در طيف HF و فراتر از آن غيرعملی هستند. به منظور به حداکثر رساندن فرکانس تشدید کننده که توسط عبارت کلی زير بیان می شود

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_r}{m_r}} \quad (2)$$

سختی موثر فنر تشدید کننده  $k_r$  باید حداکثر شود در حالیکه جرم موثر  $m_r$  حداقل می شود. طرح تشدید کننده HF بهینه باید از افزایش جرم ساختار شانه و کاهش سختی انعطاف جلوگیری کند. به این دلیل، این مقاله از تشدید کننده باريکه دو سر گیردار که در شکل ۳ نشان داده شده است تحت پیکربندی بایاس معمولی و تحریک شده استفاده می کند.



<sup>8</sup> Com-capacitive transducer

<sup>9</sup> Folded- beam suspension

شکل ۳. طرح پرسپکتیو باریکه دو سر گیردار تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$ <sup>۱۱</sup> با پیکربندی بایاس معمولی و تحریک. به نیروی ورودی مکانیکی  $f_c$  توجه کنید.

فرکانس تشدید این باریکه دو سر گیردار به عوامل بسیاری بستگی دارد که شامل هندسه، ویژگی مواد ساختاری، فشار، بزرگی ولتاژ بایاس  $V_P$ ، توپوگرافی سطح می باشد. با در نظر گرفتن این ها در حالیکه اثرات عرض محدود نادیده گرفته می شود، عبارت و فرمولی برای فرکانس تشدید می تواند نوشته شود

$$f_0 = f_{\text{nom}}[1 - g(d, V_P)]^{1/2}, \quad f_{\text{nom}} = 1.03\kappa \sqrt{\frac{E}{\rho}} \frac{h}{L_r^2} \quad (3)$$

که  $E$  و  $p$  مازول های Young و تراکم مواد ساختاری می باشند،  $h$  و  $L_r$  در شکل ۳ مشخص شده اند، تابع فرکانس تشدید مکانیکی اسمی از تشدیدکننده است اگر هیچ الکترود یا ولتاژ اعمال شده ای وجود نداشته باشد، تابع  $g$  اثر سختی فنر الکتریکی  $k_e$  را مدل سازی می کند که زمانی ظاهر می شود که الکترود و ولتاژ معروفی شده باشند و از سختی مکانیکی  $k_m$  کسر شود و  $k$  عامل اندازه گیری است که تاثیرات توپوگرافی سطح را مدل سازی می کند (که در شکل ۱۲ و ۱۳ نشان داده شده است). برای تشدید کننده  $\mu$  این کار،  $k$  توسط اثرات الاستیکی محدود و تقویت انکر در نظر گرفته می شود (۱۷)، (۱۸) که با استفاده از تحلیل عوامل محدود (FEA) قابل پیش بینی هستند.

## A. عملیات الکتروومکانیکی

تشدیدکننده های این کار از مبدل خازن برای ساده سازی تزویج آتی با مدار ترانزیستور استفاده می کند. برای باریکه دو سر گیردار توصیف شده ی طرح مقاومت عمودی، خازن ترانسفورماتور بین باریکه تشدیدکننده و الکترود مربوطه شکل می گیرد همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است. برای بکار انداختن یک تشدیدکننده، ولتاژ ورودی که شامل بایاس  $V_P$  و سیگنال  $v_i$  ac است، در خازن ترانسفورماتور الکترود به تشدیدکننده به کار گرفته می شود. (توجه داشته باشید که بایاس  $V_P$  به طور موثر برای یک صفحه ی خازن به کار گرفته می شود، هیچ

جريان  $dc$  مرتبط با آن وجود ندارد پس هیچ مصرف انرژی  $dc$  ای نیز وجود ندارد). این ترکیب ولتاژها یک نیروی الکترواستاتیک بین الکترود و تشیدکننده ایجاد می کند که با مولفه اصلی در فرکانس  $v_i$  که توسط (۹)، (۱۰) نشان داده شده است

$$F_d = V_P \frac{\partial C}{\partial x} v_i \quad (4)$$

که  $\partial C / \partial x$  تغییر حازن الکترود به تشیدکننده در هر جاچایی تشیدکننده است که تقریباً توسط مورد زیر داده شده است

$$\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{\varepsilon_0 W_r W_e}{d_0^2} \quad (5)$$

که  $d_0$  فضایی فاصله الکترود به تشیدکننده تحت شرایط استاتیک (غیر مقاوم) می باشد. زمانی که فرکانس  $v_i$  با فرکانس تشید تطبیق داده می شود، باریکه با بزرگی جاچایی صفر تا پیک در موقعیت  $z$  مرتعش می شود که توسط معادله زیر داده شده است

$$x(y) = \frac{Q F_d}{k_{\text{ref}}(y)} = \frac{Q}{k_{\text{ref}}(y)} V_P \frac{\partial C}{\partial x} v_i \quad (6)$$

که جریان  $i_x$  ایجاد می کند که در ارتباط با (۱) توصیف شده است. در (۶)،  $k_{\text{ref}}(y)$  سختی موثری در موقعیت  $y$  وجود دارد که بعداً در این بخش از طریق تزویج پهنهای الکترود تعیین می شود. زمانی که در برابر فرکانس ورودی رسم شود،  $i_x$  طیف بیضوی میان گذر را که در شکل ۳ ظاهر شده است نشان می دهد. برای طرح تشیدکننده این مقاله، (که در حدول  $10 \mu\text{V}$  خلاصه شده است)، بزرگی ارتعاش معمولی  $A^{49}$  در باریکه مرکز برای بایاس  $dc$  از

$$V_P = 10 \text{ V} \quad \text{و ولتاژ ورودی ac از } v_i = 3 \text{ mV.}$$

ویژگی فرکانس برای تشیدکننده مکانیکی  $\mu$  پلی سیلیکون  $8,5$  مگاهرتزی که در شرایط خطی در فشار  $70 \text{ mTorr}$  از طریق برنامه آزمایشی که در بخش VI توصیف شده اندازه گیری شده است، در شکل ۴ نشان داده شده است. عامل کیفیت  $Q$  استخراج شده از این طرح  $8000$  است که برای ارائه فیلترهای تلفات جای گزینی پایین بسیار

مناسب است. با این وجود به یاد داشته باشید این  $Q$  تنها در خلا قابل دسترسی است که تعديل گاز ویسکوز به حداقل می رسد (۱۹).  $Q$  پایین تر در رده صد تحت فشار جوی مشاهده می شود.

#### B. مدار مکانیکی پارامتر فشرده معادل<sup>۱۰</sup>

به منظور طرح فیلتر، اغلب می توان معادل پارامتر فشرده مدار مکانیکی تعديل کننده جرم فنر را برای این تشدیدکننده تعریف کرد (به شکل ۱ رجوع شود)، که دارای عاملی با ارزشی است که با موقعیت در تشدیدکننده تغییر می کند. با ارجاع به شکل ۵، جرم برابر در موقعیت ۷ بر تشدیدکننده توسط معادله زیر داده شده است (۲۰)

$$m_r(y) = \frac{KE_{\text{tot}}}{(1/2)(v(y))^2} = \frac{\rho W_r h \int_0^{L_r} [X_{\text{mode}}(y')]^2 dy'}{[X_{\text{mode}}(y)]^2} \quad (7)$$

که

$$X_{\text{mode}}(y) = \zeta(\cos ky - \cosh ky) + (\sin ky - \sinh ky) \quad (8)$$

برای حالت اصلی،  $KE_{\text{tot}}$  انرژی حرکتی پیک در سیستم،  $v(y)$  شتاب در موقعیت ۷ و پارامترهای ابعادی در شکل ۵ داده شده است. سختی معادل فنر از (۲) و (۷) می باشد و در معادله زیر داده شده است

$$k_r(y) = \omega_0^2 m_r(y) \quad (9)$$

که  $\omega_0$  رادیان فرکانس تشدیدکننده از باریکه است. در آخر عامل تعديل به صورت زیر داده شده است

$$c_r(y) = \frac{\sqrt{k_m(y)m_r(y)}}{Q_{\text{nom}}} = \frac{\omega_{\text{nom}} m_r(y)}{Q_{\text{nom}}} = \frac{k_m(y)}{\omega_{\text{nom}} Q_{\text{nom}}} \quad (10)$$

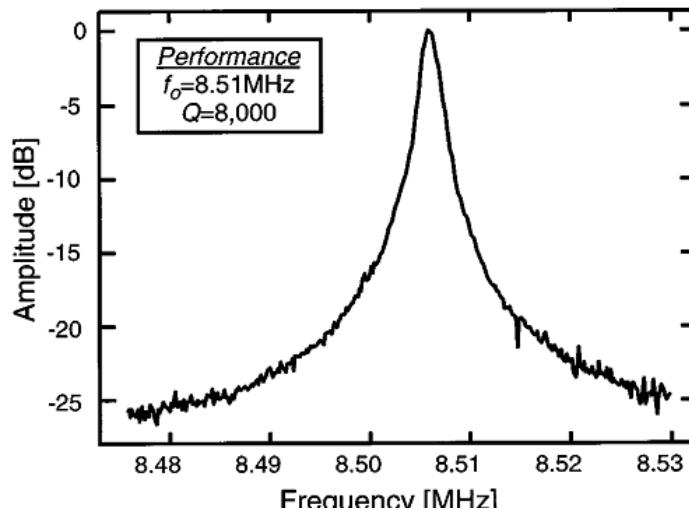
که

$$k_m(y) = \omega_{\text{nom}}^2 m_r(y) \quad (11)$$

---

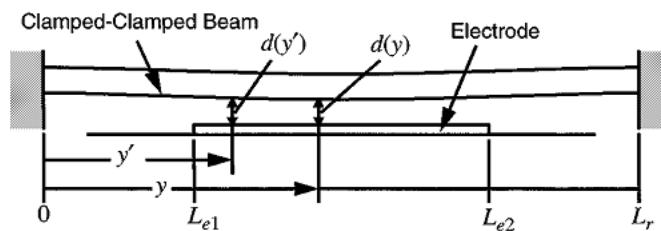
<sup>10</sup> Lumped parameter

سختی مکانیکی تشدیدکننده به تنها بی تاثیر اعمال شده و الکترود است و  $Q_{\text{nom}}$  عامل کیفیت تشدیدکننده تحت شرایط یکسان می باشد.



شکل ۴. ویژگی فرکانس برای تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  پلی سیلیکون ۸,۵ مگاهرتز اندازه گیری شده تحت خلا با استفاده از ولتاژ بایاس  $V_i = 3 \text{ mV}$ ,  $V_P = 10 \text{ dc mTorr}$  و تشدیدکننده ترانزیستور مقاومت با

بهره  $33 \text{ k}\Omega$  برای بدست آوردن ولتاژ خروجی  $v_0$ . بزرگی  $v_0/v_i$ .



شکل ۵. طرح مقطعی تشدیدکننده برای تحلیل فرکانس و امپدانس.

### C. سختی الکتریکی ولتاژ قابل تنظیم

همانطور که در (۳) اشاره شد، که  $g$  به عنوانتابع ولتاژ بایاس  $V_P \text{ dc}$  مشاهده شده است، فرکانس تشدید این دستگاه از طریق تنظیم  $V_P$  قابل تنظیم است (۸)، و این می تواند برای اجرای فیلتر با فرکانس مرکزی قابل تنظیم مفید باشد یا برای انحراف میان گذر ناشی از تحمل ساخت سطح محدود استفاده شود. وابستگی بایاس  $dc$  از

فرکانس تشدیدکننده از ثابت فنر الکتریکی وابسته به  $V_F$  نشات می‌گیرد که از ثابت فنر مکانیکی سیستم کسر می‌شود، سختی کلی فنر را کاهش می‌دهد  $k_r = k_m - k_e$ ؛ بنابراین فرکانس تشدید را طبق معادله زیر پایین می‌آورد

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_m - k_e}{m_r}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_m}{m_r}} \left[ 1 - \left\langle \frac{k_e}{k_m} \right\rangle \right]^{1/2} \\ = 1.03\kappa \sqrt{\frac{E}{\rho} \frac{h}{L^2}} \left[ 1 - \left\langle \frac{k_e}{k_m} \right\rangle \right]^{1/2} \quad (12)$$

که  $k_m$  and  $m_r$  نشان دهنده‌ی مقادیر در موقعیت مشخص (معمولًا موقعیت مرکزی باریکه) می‌باشد و مقدار  $\langle k_e/k_m \rangle$  باید از طریق تزویج عرض الکترود  $W_e$  بدست آید که به دلیل وابستگی موقعیت  $k_m$  می‌باشد. سختی فنر الکتریکی  $k_e$  توسط وابستگی غیرخطی خازن الکترود به تشدیدکننده  $C_n(x)$  بر جابجایی  $x$  تولید می‌شود و بر فضایی فاصله الکترود به تشدیدکننده  $d$  بستگی دارد. در موقعیت خاص  $y'$  بر عرض بسیار کم الکترود قرار دارد، تمایز در سختی الکتریکی در (۲۱) ارائه شده است

$$dk_e(y') = V_P^2 \frac{\varepsilon_0 W_r dy'}{(d(y'))^3} \quad (13)$$

که فضایی فاصله الکترود به تشدیدکننده  $d$  دیده می‌شود، از آنجاییکه باریکه به دلیل بایاس  $V_P$  dc خم می‌شود که بین الکترود و تشدیدکننده به کار گرفته می‌شود. با شناسایی اینکه حالت اصلی سختی استاتیک و داینامیک یکسان است، و فرض اینکه شکل خمیدگی استاتیک به دلیل نیروی  $dc$  توزیعی تعریف شده توسطتابع

است، فضایی فاصله می‌تواند به صورت زیر بیان شود  $X_{\text{static}}(y)$

$$d(y) = d_0 - \frac{1}{2} V_P^2 \varepsilon_0 W_r \int_{L_{e1}}^{L_{e2}} \frac{1}{k_m(y')(d(y'))^2} \frac{X_{\text{static}}(y)}{X_{\text{static}}(y')} dy' \quad (14)$$

که  $d_0$  فاصله الکترود به تشیدیکننده استاتیک با  $V_P = 0 \text{ V}$  می باشد. در (۱۴)، عبارت دوم نشان دهنده می جابجایی استاتیک از تشیدیکننده به سمت الکترود در موقعیت خاص ۷ می شود، که توسط تزویج در پهنهای الکترود از  $y = L_{e1} \text{ to } L_{e2}$  ارزیابی می شود. در این مقاله الکترود در مرکز باریکه تشیدیکننده قرار دارد و بنابراین  $L_{e2} = 0.5(L_r + W_e)$  و  $L_{e1} = 0.5(L_r - W_e)$  از آنجاییکه متغیر مطلوب  $d(y)$  بر هر دو سمت (۱۴) قرار می گیرد، یکی از آن ها در بازه عدد صحیح است، (۱۴) توسط در نظر گرفتن این حل می شود که  $d(y) = d_0$  در سمت راست باشد، و  $d(y)$  در سمت چپ را حل کند، سپس از این تابع در سمت راست استفاده کند، و تا زمانی که  $X_{\text{mode}}(y)$  همگرا شود تکرار شود. بعلاوه، برای اکثر موارد (۱۴) به تابع  $X_{\text{static}}(y)$  حساس نیست، بنابراین،  $d(y)$  داده شده توسط (۸) می تواند جایگزین  $X_{\text{static}}(y)$  با تفاوت کمتری شود. باید ذکر شود که بیشتر نسخه های (۱۴) از طریق تحلیل استاتیک قابل دستیابی هستند اما این ها اغلب شکل چندجمله ای به خود می گیرند و کمتر مشهود هستند (۱۴).

مقدار  $\langle k_e/k_m \rangle$  ممکن است با تزویج پهنهای الکترود یافت شود و توسط مورد زیر ارائه گردد

$$\left\langle \frac{k_e}{k_m} \right\rangle = g(d, V_P) = \int_{L_{e1}}^{L_{e2}} \frac{dk_e(y')}{k_m(y')}.$$
 (15)

با توجه به وابستگی های (۱۳)-(۱۵) و در نظر گرفتن مجموعه مقادیر  $V_P$ ، طراحی تشیدیکننده شکل ۳ برای فرکانس مقاومت خاص جهت تنظیم ابعاد هندسی  $L_r, W_r$  و  $W_e$  از طریق طرح CAD می باشد از آنجاییکه دیگر متغیرها در بیرون توسط فناوری ساخت تعیین می شوند.

D. ولتاژ توقف<sup>۱۱</sup>

زمانی که ولتاژ بایاس  $V_P$  اعمال شده به اندازه کافی بزرگ باشد، شکست دستگاه را به دنبال دارد که در آن باریکه تشیدیکننده به سمت الکترود کشیده می شود. این منجر به تخریب دستگاه به دلیل جریان زیادی می شود که از مسیر الکترود به تشیدیکننده عبور می کند اگر لایه دی الکتریک (برای

<sup>۱۱</sup> Pull-In Voltage

مثال اکسید یا نیترید) در بالای الکترود موجود باشد تا از تماس الکتریکی بین آن و باریکه تشیدیدکننده جلوگیری کند.

برخلاف ساختارهای میکرومکانیکی با فرکانس پایین پیشین (۸)، (۱۵)، نیروی الکترواستاتیک جالب بین الکترود و

تشیدیدکننده HF که منجر به کشش می شود در برابر سختی توزیعی بزرگ عمل می کند که باید در ناحیه الکترود

$V_{PI}$  تزویجی شود تا به درستی ولتاژ کشش  $V_{PI}$  را پیش بینی کند. بنابراین، عبارت بسته‌ی مورد استفاده برای

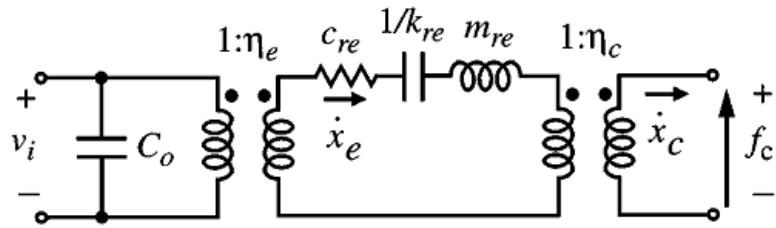
(۲۱) بر مبنای تحلیل پارامتر فشرده دیگر قابل استفاده نیستند. بلکه، برای این تشیدیدکننده، فرآیند تعیین  $V_{PI}$

شامل پیدا کردن  $V_P$  است که فرکانس تشیدید را برابر با صفر قرار می دهد، با ارجاع به (۱۲)، مقدار (۱۵) برابر با

تزویج و حل متغیر  $V_P$  است.

#### E. مدار معادل الکتریکی سیگنال کوچک

برای مدل سازی و شبیه سازی آسان رفتار امپدانس این تشیدیدکننده مکانیکی  $\mu$  در مدار الکتروومکانیکی، معادل الکتریکی مورد نیاز است (۸)، (۲۲)، (۲۳). همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است، هم ورودی و هم خروجی مکانیکی و الکتریکی برای این دستگاه ممکن است، بنابراین مدار معادل باید بتواند هر دو را مدلسازی کند. بعلاوه، برای سازگاری فیزیکی از منظر ترانسفورماتور و نویز، یک مدل مدار که مستقیماً از المنت های مکانیکی فشرده استفاده می کند و در (۷)-(۱۰) خلاصه شده است ترجیح داده می شود. شکل ۶ مدار معادل مورد استفاده در این مقاله را ارائه می دهد که در آن مبدل ها هم تزویج الکتریکی و هم مکانیکی را از تشیدیدکننده مدلسازی می کند که خودش توسط مدار اصلی LCR مدل سازی می شود- مشابه الکتریکی به سیستم تعديل کننده جرم فنر- که مقدار المنت هایش منطبق با مقدار واقعی جرم، سختی، و تعديل کننده است همانطور که توسط (۷)-(۱۰) ارائه شده است. در این مدار، شباهت الکتروومکانیکی جریان مورد استفاده قرار گرفته است همانطور که در جدول ۱ خلاصه شده است.



شکل ۶. مدار تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  با ورودی و خروجی الکتریکی (ولتاژ  $v_i$ ) و مکانیکی (نیروی  $f_c$ )

جدول ۱ تطابق مکانیکی به الکتریکی در آنالوگ جریان

متغیر الکتریکی	متغیر مکانیکی
مقاومت، $R$	تبدیل کننده، $C$
خازن، $C$	سختی $K^{-1}$
القا، $L$	جرم $m$
ولتاژ، $V$	نیرو، $f$
جریان، $I$	سرعت، $v$

زمانی که به پرت الکترود از مدار تشدیدکننده معادل در شکل ۶ می نگریم، یک مدار LCR تبدیل شده مشاهده می شود که مقادیر المنت هایش به صورت زیر می باشد

$$L_x = \frac{m_{re}}{\eta_e^2} \quad C_x = \frac{\eta_e^2}{k_{re}} \quad R_x = \frac{\sqrt{k_{re}m_{re}}}{Q\eta_e^2} = \frac{c_{re}}{\eta_e^2} \quad (16)$$

که زیرونوند  $c$  نشان دهنده می موقعیت الکترود در مرکز باریکه تشدیدکننده است (یعنی، در  $y = L_r/2$ ). عبارتی برای ترانسفورمر الکترومکانیکی نسبت  $\eta_e$  می تواند از طریق تحلیل امپدنس بدست آید که مقاومت حرکتی  $R_x$  می تواند در فاصله الکترود به تشدیدکننده در تشدیدکننده دیده شود. پیرو این،تابع تبدیل ولتاژ به جابجایی در موقعیت داده شده ۷ (در شکل ۵ مشاهده شود) در تشدیدکننده ابتدا با استفاده از فرم فازور (۴)-(۶)، (۸) و (۹) و ادغام آن در پهنهای الکترود یافت شد که

$$\frac{X}{V_i}(y) = \int_{L_{e1}}^{L_{e2}} \frac{QV_P \varepsilon_0 W_r}{[d(y')]^2 k_r(y')} \frac{X_{\text{mode}}(y)}{X_{\text{mode}}(y')} dy'. \quad (17)$$

با استفاده از فرم فازور از (۱)، مجموعه مقاومت حرکتی مشاهده شده از الکترود به صورت زیر می باشد

$$R_x = \frac{V_i}{I_x} = \left[ \int_{L_{e1}}^{L_{e2}} \frac{\omega_0 V_P \varepsilon_0 W_r}{[d(y)]^2} \cdot \frac{X}{V_i}(y) dy \right]^{-1}. \quad (18)$$

با الحاق (۱۷)، فاکتور گیری  $\eta_e$  داریم  $c_{re} = k_{re}/(\omega_0 Q)$ ، و کسر

$$\eta_e = \sqrt{\int_{L_{e1}}^{L_{e2}} \int_{L_{e1}}^{L_{e2}} \frac{V_P^2 (\varepsilon_0 W_r)^2}{[d(y') d(y)]^2} \frac{k_{re}}{k_r(y')} \frac{X_{mode}(y)}{X_{mode}(y')} dy' dy}. \quad (19)$$

توجه داشته باشید که سختی مجتمع شده‌ی موثر تعریف شده در (۶) می‌تواند از (۱۷) نیز کسر شود، که می‌دهد

$$k_{eff}(y) = \left[ \int_{L_{e1}}^{L_{e2}} \left[ \frac{d_0}{d(y')} \right]^2 \frac{1}{k_r(y')} \frac{1}{W_e} \frac{X_{mode}(y)}{X_{mode}(y')} dy' \right]^{-1}. \quad (20)$$

نسبت تبدیل ترانسفورمر  $\eta_c$  در شکل ۶ تبدیل امپدنس مکانیکی را مدلسازی می‌کند که توسط تزویج مکانیکی به تشدیدکننده در موقعیت  $y$  که از مرکز جابجا شد بدست آمد. همانطور که مشاهده می‌شود، چنین تزویجی به هنگام اجرای فیلترها با دو یا چند تشدیدکننده مورد نیاز خواهد بود. با بیان این موارد در قالب نسبت سختی، معادله

برای نسبت تبدیل ترانسفورمر به هنگام تزویج در فاصله  $l_c$  از انکر شکل زیر را به خود می‌گیرد

$$\eta_c = \sqrt{\frac{k_r y = l_c}{k_{re}}}. \quad (21)$$

در نهایت، برای مدار معادل از شکل ۶، باید توجه شود که ثابت تعديل کننده  $c_r$  اساساً تابعی از سختی الکتریکی  $k_e$  نیست. بنابراین، زمانی که در قالب سختی کلی  $k_r$  سیستم بیان شد،  $Q$  تشدیدکننده باید تنظیم شود تا اینکه مقدار اصلی خود را حفظ کند که توسط (۱۰) داده شده است. در قالب  $c_r$  و  $\omega_0$ ، معادله برای شکل زیر را به خود می‌گیرد

$$c_r = \frac{\omega_0 m_r}{Q} = \frac{k_r}{\omega_0 Q} = \frac{\sqrt{k_r m_r}}{Q} \quad (22)$$

$$Q = Q_{\text{nom}} \left[ 1 - \left\langle \frac{k_e}{k_m} \right\rangle \right]^{1/2}. \quad (23)$$

توجه داشته باشید که عامل کیفیت تشدیدکننده موثر  $Q$  به سختی فنر الکتریکی  $k_e$  بستگی دارد و بنابراین تابع ولتاژ بایاس  $V_P$  dc از  $Q_{\text{nom}}$  تعیین شده است در حالیکه برای شرایط بایاس صفر قرار گرفته است.

#### IV

### طرح فیلتر

علاوه‌گم استفاده از تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  مرتباً به جای LCR دومجذوری یا مبتنی بر ترانزیستور، توبولوژی شبکه برای فیلترهای مکانیکی این کار از مواردی که کاملاً الکترونیکی هستند متفاوت می‌باشد و در واقع، می‌تواند در سطح سیستم طراحی شود که از طریق تکنیک تحلیل فیلتر نردبانی تشدیدکننده نشات می‌گیرد. به ویژه، با توجه به مقادیر عامل LCR برای تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  نمونه اولیه، ترکیب فیلتر مکانیکی در دامنه الکتریکی ممکن است که دامنه مکانیکی را تنها به عنوان مرحله نهایی تبدیل کند. با این وجود، اگرچه ممکن است، چنین روندی توصیه نشود، زیرا دانش و سهولت طراحی در هر دو دامنه مکانیکی و الکتریکی می‌تواند تلاش‌های مورد نیاز را کاهش دهد.

رونده طراحی فیلتر میکرومکانیکی دو تشدیدکننده در این مقاله می‌تواند به صورت زیر مشخص شود.

۱) نمونه اولیه تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  مورد استفاده را ایجاد و طراحی کنید، هندسه ضروری برای فرکانس‌های مورد نیاز را انتخاب کرده و اطمینان حاصل کنید که مبدل الکترود به تشدیدکننده تزویج وجود دارد تا پایان مقادیر مقاومت از پیش تعیین شده را فراهم کند.

۲) مقدار قابل تولید از پهنانی باریکه تزویج  $W_s$  فراهم کنید و باریکه تزویج را با ربع طول موج از فرکانس مرکزی فیلتر انتخاب کنید.

۳) موقعیت‌های تزویج بر تشدیدکننده منطبق با پهنانی باند مورد علاقه را تعیین کنید.

۴) معادل کاملی از مدار برای فیلتر کلی تولید کنید و طرح را با استفاده از شبیه سازی مدار تایید کنید.

هر یک از مراحل فوق توضیح داده خواهد شد.

## A. طرح تشدیدکننده میکرومکانیکی

تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  شامل فیلترها ترجیحا به صورت یکسان طراحی شده اند که هر یک فرکانس تشدیدکننده منفردی دارند. طراحی معادله هایی که ابعاد و ولتاژهای بایاس را طراحی می کند باید فرکانسی داشته باشد که در بخش III ارائه شده است.

علاوه بر تعیین فرکانس مرکزی فیلتر، طراحی تشدیدکننده نیز پایانه مقاومت های مورد نیاز برای صاف کردن میان گذر را تعیین می کند. مانند فیلترهای نرdbانی LC، فیلترهای مکانیکی  $\mu$  توصیف شده باید با مقدار امپدانس مناسب نهایی شود. بدون پایانه مناسب، تشدیدکننده  $Q$  بسیار بزرگ است و میان گذر فیلتر شامل پیک های مجزای انتخاب است همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است. به منظور صاف کردن میان گذر بین پیک ها،  $Q$  تشدیدکننده (دقیقا پایان تشدیدکننده) باید کاهش پیدا کند و این می تواند با تعیین فیلتر با مقاومت انجام شود. مقدار مورد نیاز پایانه مقاومت برای فیلتر مکانیکی  $\mu$  با فرکانس مرکزی  $f_0$  و پهنهای باند  $B$  به صورت زیر داده شده است

$$R_{Qi} = \left( \frac{Q}{q_i Q_{\text{fltr}}} - 1 \right) R_{xi} \quad (24)$$

که  $Q$  عامل کیفیت بارنشده  $i$  تشدیدکننده است،  $Q_{\text{fltr}} = f_0/B$ ،  $i$  به انتهای تشدیدکننده مورد نظر اشاره می کند، و  $Q \gg Q_{\text{fltr}}$  پارامتر  $q$  نرمال شده است که از فیلتر بدست می آید (۲۴). برای مورد رایج که  $Q \gg Q_{\text{fltr}}$ ، (۲۴) می شود

$$R_{Qi} \cong \frac{\sqrt{k_{\text{rie}} m_{\text{rie}}}}{q_i Q_{\text{fltr}} \eta_e^2} = \frac{k_{\text{rie}}}{\omega_0 q_i Q_{\text{fltr}} \eta_e^2}. \quad (25)$$

از متغیرها در (۲۵)، عامل تزویج الکترومکانیکی  $\eta_e$  اغلب برای تنظیم مقدار مطلوب مقاومت راحت‌تر است.

بنابراین، با در نظر گرفتن (۱۹) و (۲۵)، امپدنس نهایی  $R_{Qi}$  و محدودیت‌های ولتاژ بایس  $V_P$  اغلب نشان دهنده‌ی فضا الکترود به تشیدیدکننده است و با طرح تشیدیدکننده خاص همپوشانی دارد.

## B. طرح باریکه تزویج

اگر هر تشیدیدکننده طوری طراحی شده است که فرکانس تشیدیدکننده یکسان داشته باشد، سپس میان گذر فیلتر کلی در حول این فرکانس قرار خواهد گرفت. فنر تزویج به طور موثر عمل می‌کند تا فرکانس‌های تشیدیدکننده را جدا کند، دو حالت تشیدید بسته ایجاد می‌کند که شامل پایانه میان گذر فیلتر است. برای فرکانس مرکزی فیلتر داده شده  $f_0$  و پهنه‌ای باید  $B$ ، ثابت فنر باریکه تزویج مورد نیاز می‌تواند با استفاده از معادله زیر بدست آید (۲۰)، (۲۴)

$$k_{s12} = k_{rc} \left( \frac{B}{f_0} \right) k_{12} \quad (26)$$

که سختی تشیدیدکننده در موقعیت تزویج و  $k_{12}$  ضریب تزویج نرمال شده بین تشیدیدکننده برای نوع فیلتر  $k_{s12}$  داده شده است (یعنی Butterworth, Chebyshev و غیره) (۲۴). مقدار مورد نیاز ثابت فنر تزویجگر توسط انتخاب مناسب هندسه باریکه تزویجگر با استفاده از عبارت تعیین شده بدست می‌آید.

طرح باریکه تزویج کننده توسط این حقیقت پیچیده می‌شود که خود باریکه جرم محدود دارد. بویژه، برای مورد فیلترهای ریزمقیاس، جرم باریکه تزویج کننده به همان ترتیبی است که باریکه‌های تشیدیدکننده هستند. مگر اینکه برای آن در نظر گرفته نشود، این جرم باریکه می‌تواند به جرم‌های تشیدیدکننده کناری بیافزايند، بنابراین فرکانس تشیدیدکننده فردی شان را تغییر دهنده همانطور که توسط (۲) اشاره شده است، که فرکانس مرکزی فیلتر را تغییر می‌دهد یا میان گذرش را منحرف می‌سازد اگر از بیش از دو تشیدیدکننده استفاده کند. این در شکل ۷ نشان داده شده است، که نشان دهنده‌ی مورد خاصی است که هر تشیدیدکننده به طور موثر نیمی از جرم فنر تشیدیدکننده را می‌گیرد که منجر به تغییر کلی در فرکانس مرکزی فیلتر می‌شود همانطور که در شبیه سازی دیده شد.

اگرچه آموزنده است، شکل ۷ در واقع تنها مورد خاصی را توصیف می کند که طول باریکه تزویج کننده کمتر از هشتمنی طول موج آکوستیک است که منطبق با فرکانس عملیات است. برای این مورد خاص، باریکه تزویج کننده می تواند توسط سیستم فر جرم فشرده نشان داده شود. در واقع، با این وجود، بویژه در فرکانس های بالا، باریکه تزویج توسط خط انتقال آکوستیک مدل سازی می شود- آنالوگ مکانیکی خط انتقال الکتریکی مشابه می باشد. برای این خط انتقال مکانیکی، مدار مکانیکی توزیعی قابل استفاده است و میزان جرم باریکه تزویج کننده و سختی که به طور موثر توسط تشدیدکننده های مجاور قابل مشاهده است با ابعاد باریکه و فرکانس عملیات تغییر می کند. به منظور طراحی فیلتر، شکل ۸ نشان دهنده ای مدل خط انتقال کلی برای باریکه تزویج است که شامل شبکه T از امپدانس مکانیکی است.

به دنبال تعیین مقادیر  $Z_a$ ,  $Z_b$ , and  $Z_c$  در شکل ۸، رفتار امپدانس مکانیکی باریکه تزویج کننده همانطور که توسط تشدیدکننده کناری دیده می شود می تواند توسط ماتریس امپدانس شکل (۲۵) مدلسازی شود

$$\begin{bmatrix} f_1 \\ \dot{x}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{H_6}{H_7} & -\frac{2EI_s\alpha^3H_1}{j\omega L_s^3H_7} \\ -\frac{j\omega L_s^3H_3}{EI_s\alpha^3H_7} & \frac{H_6}{H_7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_2 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_2 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} \quad (27)$$

که

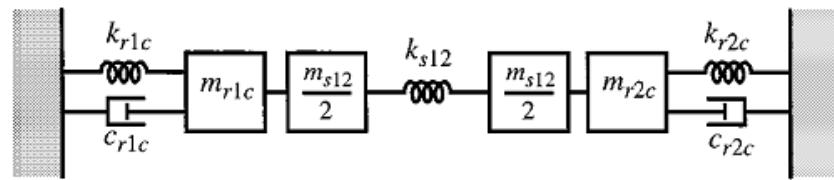
$$H_1 = \sinh \alpha \sin \alpha \quad (28)$$

$$H_3 = \cosh \alpha \cos \alpha - 1 \quad (29)$$

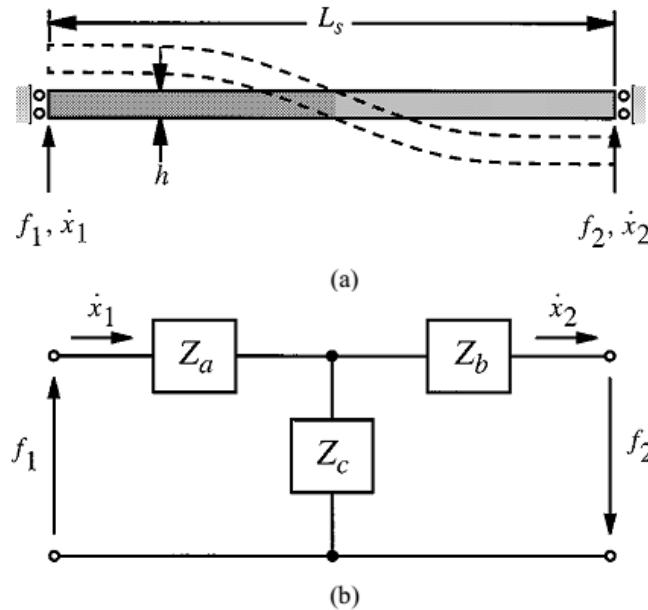
$$H_6 = \sinh \alpha \cos \alpha + \cosh \alpha \sin \alpha \quad (30)$$

$$H_7 = \sin \alpha + \sinh \alpha. \quad (31)$$

$\alpha = L_s(\rho W_s h \omega^2 / (EI_s))^{0.25}$ ,  $I_s = W_s h^3 / 12$ ,  $W_s$  پهنهای باریکه تزویج است، ابعاد مورد نیاز دیگر در شکل ۸ (الف) داده شده است، و فرض می کنیم که چرخش باریکه تزویج در نقاط ارتباط معنادار ندار. برای مواردی که چرخش مهم است، ماتریس در (۲۷) بزرگ تر می شود (۲۵) اما روش های راه حل مشابه باقی می ماند.



شکل ۷. مدار مکانیکی معادل برای فیلتر دو تشدیدکننده شکل ۱ (الف) با استفاده از باریکه تزویج با طول کمتر از یک هشتم طول موج فرکانس عملیاتی.



شکل ۸. (الف) باریکه تزویج تحت نیروهای  $f_1$  و  $f_2$  با واکنش های سرعت منطبق. (ب) خط انتقال کلی مدل T برای باریکه تزویج.

برابر قرار دادن مدار شکل ۸ (ب) به شبکه زنجیری توصیف شده توسط (۲۷) (۲۴)، پس حل این مجموعه و امپدانس در قالب عناصر ماتریس زنجیری به صورت زیر است

$$Z_a = Z_b = \frac{A - 1}{C} = \frac{jEI_s\alpha^3(H_6 - H_7)}{\omega L_s^3 H_3} \quad (32)$$

۹

$$Z_c = \frac{1}{C} = \frac{jEI_s\alpha^3 H_7}{\omega L_s^3 H_3}. \quad (33)$$

به منظور کاهش آسیب پذیری به واریانس هندسی باریکه (یعنی واریانس جرم) منجر شده توسط طرح محدود تحمل ساخت، باریکه تزویج باید طوری طراحی شود که منطبق با یک چهارم طول موج فرکانس مرکزی فیلتر باشد. این می‌تواند با انتخاب ابعاد باریکه تزویج بدست آید طوری که مجموعه و امپدانس موازی شکل ۸(ب) مقادیر برابر و متضاد  $Z_a$  and  $Z_c$  مقادیر برابر و متضاد می‌گیرد و بنابراین هر مش را کنسل می‌کند. با بررسی (۳۲) و (۳۳)، می‌تواند زمانی که

$$H_6 = \sinh \alpha \cos \alpha + \cosh \alpha \sin \alpha = 0. \quad (34)$$

با استفاده از مقادیر منتخب  $W_s$  (در مرحله ۲) در بخش IV و با فرض اینکه  $h$  برابر با فناوری است، (۳۴) می‌تواند برای  $L_s$  حل شود که منطبق با یک چهارم طول موج فرکانس عملیاتی است. با ابعاد کاپلر یک چهارم طول موج، امپدانس شکل ۸(ب) به صورت زیر داده شده است

$$Z_a = Z_b = \frac{EI_s H_7}{j\omega L_s^3 H_3} = \frac{k_{sa}}{j\omega} \quad (35)$$

و

$$Z_c = -\frac{EI_s H_7}{j\omega L_s^3 H_3} = \frac{k_{sc}}{j\omega}. \quad (36)$$

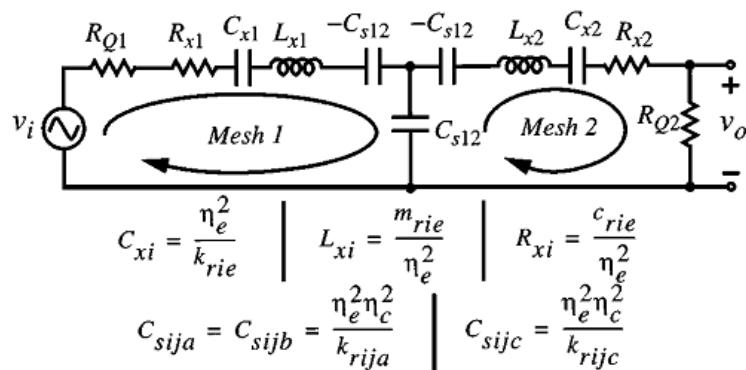
از این معادلات، با کمک (۲۹) و (۳۱) به منظور گسترش، سختی باریکه تزویج کننده یک چهارم طول موج به صورت زیر می‌باشد

$$k_{sc} = -k_{sa} = -\frac{EI_s \alpha^3 (\sin \alpha + \sinh \alpha)}{L_s^3 (\cos \alpha \cosh \alpha - 1)}. \quad (37)$$

باید ذکر شود که علاوه بر کاهش آسیب پذیری فیلتر کلی نسبت به واریانس در هندسه باریکه تزویج کننده، استفاده از باریکه تزویج کننده یک چهارم طول موج استفاده از تشدیدکننده یکسان در فیلتر را ممکن می‌سازد. این شاید در دامنه الکتریکی در زمینه‌ی شبکه فیلتر ساده شده که در شکل ۹ نشان داده شده است بهتر توصیف شود، که با استفاده از آنالوگ الکترومکانیکی جدول ۱ بر مدار مکانیکی فشرده از شکل ۱(ب) بدست آمده است. در اینجا،

مدارهای LCR نشان دهنده‌ی تشدیدکننده و مدل‌های شبکه T باریکه تزویج کننده است. در نتیجه ترکیب فیلتر، یک ویژگی شبکه این است که هر مش با دیگر مدارهای باز باید در فرکانس مرکزی فیلتر  $f_0$  تشدید شود (۲۴). با بررسی مش ۱، با مش ۲ مدار باز، خازن‌های  $C_{s12a} = -C_{s12}$  و  $C_{s12c} = C_{s12}$  کنسل می‌شوند، تنها  $L_x$  و  $C_x$  تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  را باقی می‌گذارد تا منجر به فرکانس مش ۱ شود. همین مورد برای مش ۲ با مش ۱ مدار باز نیر به کار گرفته می‌شود. بنابراین، زمانی که باریکه‌های تزویج کننده طول موج یک چهارم استفاده می‌شوند، همه‌ی تشدیدکننده‌های شامل فیلتر باید یکسان باشند هر یک در فرکانس مرکزی فیلتر تشدید شود.

موجود بودن طراحی‌ها با استفاده از تشدیدکننده‌های یکسان برای مورد فیلترهای میکرو مکانیکی ساخت شده‌ی مسطح مهم است از آنجاییکه تشدیدکننده‌های منطبق راحت‌تر در فرآیند صفحه بدبست می‌آیند نسبت به تشدیدکننده‌هایی با فرکانس‌های خاص و متغیر، یعنی تحمل تطبیق بهتر از تحمل واقعی در فرآیند مسطح است.



شکل ۹. مدار معادل ساده برای فیلتر میکرومکانیکی شکل ۱ با استفاده از باریکه تزویج کننده یک چهارم طول

موج.

### C. موقعیت تزویج کننده (تزویج کننده با سرعت کم)

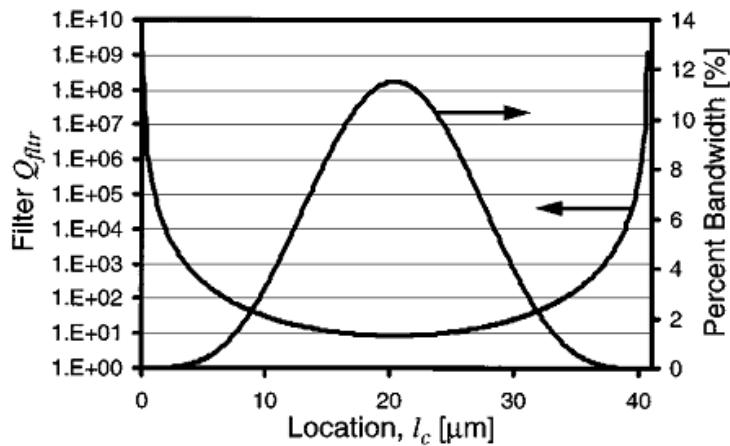
حداکثر عامل کیفیت فیلتر ( $Q_{\text{fltr}} = f_0/B$ ) که از طریق فیلتر مکانیکی قابل دسترسی است برای نسبت تشدید کننده و ثابت‌های فر برایکه تزویج  $k_{rc}/k_{s12}$  نسبی است و با استفاده از (۲۶) داده شده است

$$Q_{\text{fltr}} = \frac{1}{P_{\text{BW}}} = k_{12} \left( \frac{k_{rc}}{k_{s12}} \right) \quad (38)$$

که  $P_{BW}$  درصد پهنانی باند است. برای مورد فیلترهای مکانیکی ماکروسکوپی،  $k_{rc}/k_{s12}$  می تواند بسیار بزرگ باشد زیرا تشدیدکننده ها اغلب بزرگ تر و ضخیم تر از فنرهای تزویج مرتبط شان هستند (۲۰). از سوی دیگر، در فیلترهای مکانیکی  $\mu$ ، تشدیدکننده ها و کاپلرها معمولاً اندازه مشابه دارند و بنابراین، نسبت  $k_{rc}/k_{s12}$  محدود است. این،  $Q_{fltr}$  قابل دسترسی را قابل دستیابی است (یا درصد پهنانی باند).

روش جدید برای بدست آوردن  $Q_{fltr}$  بزرگ تر دارای مزیت این حقیقت است که ثابت فنر دینامیک  $k_{rc}$  از تیر دو سر گیردار در موقعیت های نزدیک تر به نقطه انکر دیگر بزرگ تر است- یعنی در نقاطی که به سمت سرعت تشدیدکننده پایین تر حرکت می کند بزرگ تر است. این م می تواند از (۷) و (۹) مشاهده شود، که به جرم و سختی تشدیدکننده تابعی از موقعیت باریکه را می دهد. بنابراین، با تزویج باریکه نزدیک تر به نقاط انکر، به جای مرکز باریکه تشدیدکننده،  $k_{rc}/k_{s12}$  بالاتر می تواند بدست آید و بنابراین  $Q_{fltr}$  بالاتر نایل می شود حتی زمانی که تشدیدکننده و فنرهای تزویج اندازه های یکسان داشته باشد.

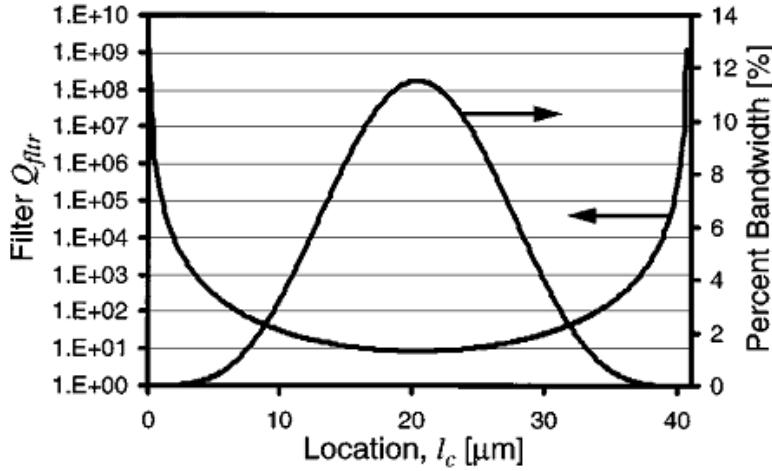
شکل ۱۰ این نقطه با  $Q_{fltr}$  در برابر موقعیت تزویج  $l_c$  در راستای باریکه تشدیدکننده را نشان می دهد. همانطور که نشان داده شده است،  $Q_{fltr}$  نزدیک نقاط انکر بالاتر است که سرعت پایین تر است، و باریکه نزدیک کوجک تر است، که سرعت به حداقل می رسد. از آنجاییکه  $Q_{fltr}$  پهنانی باند است، شکل ۱۰ نشان می دهد که پهنانی باند فیلتر می تواند با انتخاب مناسب موقعیت انجام شود که در آن تشدیدکننده و باریکه تزویج کننده به هم می رسند. این ویژگی راحت است، از آنجاییکه منجر به استفاده از مجموعه هندسه باریکه تزویج کننده می شود. به عبارت دیگر، باریکه تزویج کننده نباید دوباره طراحی شود تا فیلترها را با پهنانی باند متفاوت جای دهد، تنها باریکه تزویج کننده ربع طول موج باید طراحی شود- با طول، پهنا و ضخامت مشخص- و پهنانی باند فیلتر می تواند با تغییر موقعیت تشدیدکننده مجتمع به کاپلر تغییر یابد.



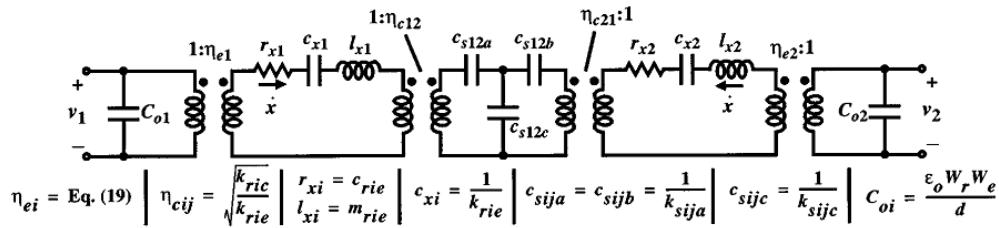
شکل ۱۰. طرح شبیه سازی  $Q_{\text{fltr}}$  و پهنای باند درصد در برابر موقعیت تزویج کننده  $l_c$  در راستای طول باریکه تشدید کننده.

#### D. مدار معادل و تایید طراحی

اگرچه برای هدف مورد نظر مفید است، شکل ۹ تنها مدار معادل الکتریکی ساده شده را برای فیلتر مکانیکی  $\text{H}$  ساده شده دو تشدید کننده ارائه می دهد. بویژه، یک مدار LCR مدار معادل برای تشدید کننده مکانیکی  $\text{H}$  را ساده می کند که در فیلتر مورد استفاده بود است زیرا دستگاهی را به عنوان یک پرت مدلسازی می کند. تشدید کننده فیلتر دستگاه های دو پرتی است، یک پرت الکترود و دیگری در موقعیت کوپلینگ فنر است و نیروی اعمال شده برای هر یک از این پرت ها ترکیب می شود تا واکنش کلی تشدید کننده  $\text{H}$  را تولید کند. با در نظر گرفتن این مورد، شکل ۱۱، یک مدار معادل مناسب برای فیلتر کلی ارائه می دهد که هر تشدید کننده اکنون توسط مدار شکل ۶ مدلسازی می شود و مبدل امپدانس مکانیکی تزویج کننده فنر از طریق ترانسفورمر با نسبت  $\eta_{cij}$  مدلسازی می شود. برای سهولت خواندن، عبارت ها و معادلات برای عناصر مدار با طرح مدار در شکل ۱۱ خلاصه شده است.



شکل ۱۰. طرح شبیه سازی شده  $Q_{\text{fltr}}$  و درصد پهناز باند در برابر موقعیت تزویج کننده  $l_c$  در راستای طول باریکه تشدید کننده.



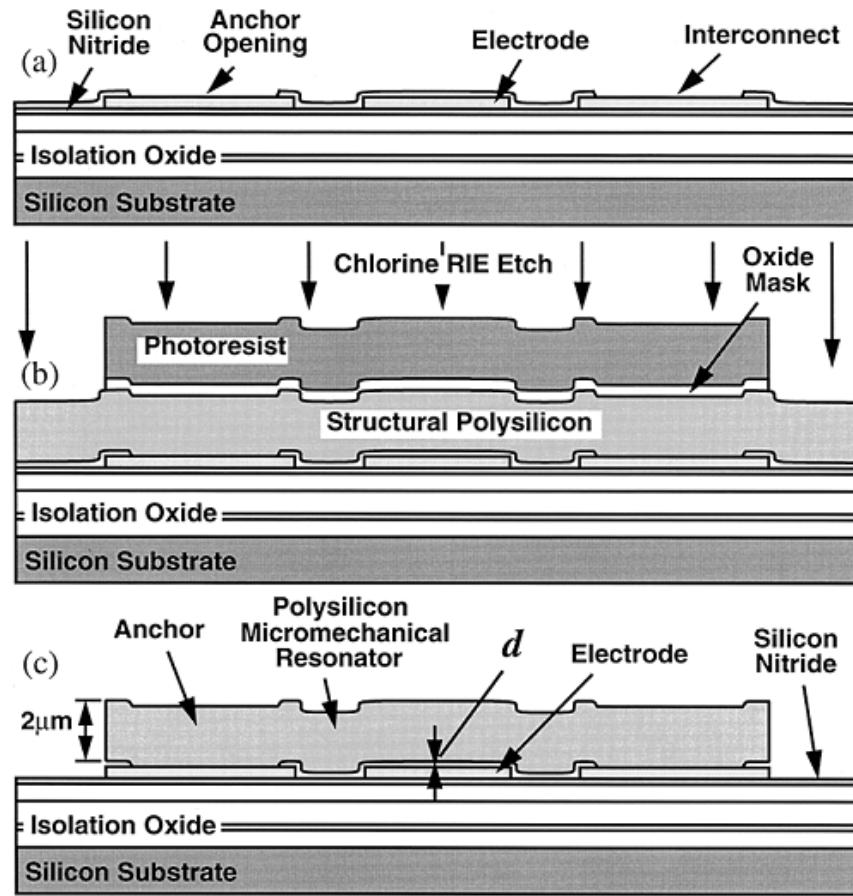
شکل ۱۱. مدار معادل کامل برای فیلتر میکرومکانیکی شکل ۱، مدلسازی طرح تزویج کننده طول موج یک چهارم و موقعیت تزویج کننده سرعت پایین. معادلات و عبارات برای عناصر در بر گرفته شده است.

ساخت

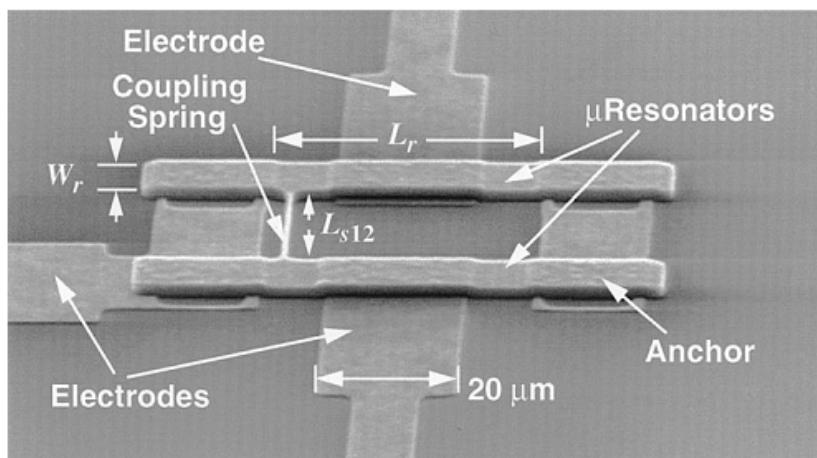
یک فناوری ریزماشین کاری سطح پلی سیلیکون همانند نسخه هایی که پیش تر گزارش شد (۹)، (۱۰)، به استثنای تمایز مهمی که ضخامت اکسیده در این فرآیند دارد و  $A1300\text{A}$  است، مورد استفاده قرار گرفت تا فیلتر مکانیکی این مقاله را تولید کند. در این فرآیند، مجموعه ای از مراحل رسوب لایه و الگوبندی لیتوگرافی - که مشابه مراحل مورد استفاده در فناوری های ساخت IC مسطح هستند - مورد استفاده قرار گرفت تا مورد مقطعی ای را بدست آورد که در شکل ۱۲(الف) نشان داده شده است. در اینجا، الکتروود O/I پلی سیلیکان فسفری و اتصال میانی (ضخامت ۳۰۰۰A) توسط لایه ضخیم A1300 از دی اکسید سیلیکون LPCVD پوشیده شد، به جز قسمت های مرطوب تا به

عنوان انکر برای تشدیدکننده های پایانه عمل کند. یک لایه پلی سیلیکون ساختاری با ضخامت ۲  $\mu\text{m}$  از طریق LPCVD در ۵۸۵ درجه C می باشد و از طریق گاز POL3 را ممکن می سازد. A ۵۰۰۰ از SiO<sub>2</sub> مانع نفوذ در بار از دست دادن در طول فشار ۱۰۵۰ درجه C و توزیع dopant می شود، سپس به عنوان ماسک مقاوم در برابر ساختار لایه پلی سیلیکون ساختاری از طریق یون واکنشی پلاسمما با چگالی بالا، و مبتنی بر کلوراید عمل می کند (شکل ۱۲(ب)). توجه داشته باشید که در کل این فرآیند، لایه اکسید از مواد پلی سیلیکان ساختاری در طول رسوب، الگوبندی و گداختگی پشبیانی می کند و فاصله الکترود به تشدیدکننده  $d_0$  را تعریف می کند. در مرحله نهایی فرآیند، ویفر به محلول هیدروفلوریک اسید وارد می شود که لایه اکسید را بدون حمله به مواد ساختاری پلی سیلیکان دور می کند. این ساختار آزادانه نشان داده شده در شکل ۱۲(پ) را آزاد می گذارد تا در چندین ابعاد حرکت کند اگر ضروری باشد. انتشار و آزادی به همراه آلایش گستردگ است که شامل نفوذ ۱۰ دقیقه ای در محلول H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> and H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> و همینطور آلایش CO<sub>2</sub> می باشد تا موارد جانبی و دیگر باقیمانده ها را از خلا نازک الکترود به تشدیدکننده جدا کند.

فیلترهای میکرومکانیکی با فرکانس های مرکزی از ۳ به ۱۵ مگاهرتز با استفاده از روندهایی طراحی شدند که در بخش های III و IV طراحی شدند، سپس با استفاده از فناوری ریزماشین کاری سطح پلی سیلیکون فوق تولید می شوند. شکل ۱۳ اسکن میکروگراف الکترون (SEM) از فیلتر تولید شده را با مشخصات طرح نشان می دهد که در جدول II خلاصه شده است.



شکل ۱۲. تصویر مقطی فرآیند ساخت مورد استفاده برای بدست آوردن فیلتر میکرومکانیکی: (الف) الکترود پلی سیلیکون و لایه های متصل تحت اکسید با ضخامت  $A1300$ . (ب) لایه های نازک مورد نیاز و ماسک های مورد نیاز در طول الگوبندی تشدیدکننده در RIE مبتنی بر کلوراید و (پ) باریکه آزادانه به دنبال etch در اسید هیدورفلوریک.



## نتایج تجربی

شکل ۱۳. SEM از فیلتر میکرومکانیکی دو تشدیدکننده ۷,۸۱ مگاهرتز ساخته شده.

با بررسی و بایاس اولیه دستگاه های کامل، دو مشاهده انجام شد: ۱) هیچ یک از دستگاه ها بعد از انتشار HF مرتبط، استاندارد به زیرساخت متصل نبودند، و ۲) ولتاژ کششی (۸)، (۲۱) بالا بود، و در ترتیب ۷۵۰ قرار داشت، حتی برای فاصله تشدیدکننده به الکترود هدف از A1۳۰۰. هر دوی این ویژگی ها از سختی فرر بالا نشات می گیرد که برای بدست آوردن تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  HF به سختی بالای فرر نیاز دارد. immunity to stiction (۲۹)

و ولتاژ کششی بالا با برنامه های کاربردی فرکانس پایین در تضاد هستند، مانند شتاب سنج (۱۵) و حاکی از آن است که تلفات به دلیل این مکانیزم ها باید برای HF MEMS مورد استفاده در ارتباطات کمتر باشد.

از آنجاییکه عامل کیفیت تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  در خلا بزرگ است، تشدیدکننده ها و فیلترها با استفاده از محفظه (Chamber) خلا سفارشی ساخته شده مورد بررسی قرار گرفتند. این محفظه (Chamber) برای اتصال به دستگاه های خارجی و همینطور پشتیبانی داخلی برای برد مدار است. با این تنظیمات، مقاومت های پایانی نشان داده شده در شکل ۱ (الف) به اضافه بافرینگ الکترونیک برای استفاده از ابزار خارجی می تواند در محفظه خلا در کنار دستگاه های مکانیکی  $\mu$  دسته بندی با کمینه تداخلگر پارازیتی قرار گیرد. با استفاده از پمپ مکانیکی، فشار قابل دستیابی مینمم این سیستم 40 mTorr بود.

ویژگی های SEM و فرکانس برای صفحه موازی 8.5 MHz، تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  پلی سیلیکان با استفاده از ابزارهای بالا بدون مقاومت پایانی اندازه گیری شد و استفاده از تشدیدکننده ترانزیستو در شکل ۴ ارائه شد. باید اشاره شود که Q از ۸۰۰۰ در این اندازه گیری به اندازه تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  فوق بالا نیست که Q بالاتر از ۸۰۰۰ نشان داده شده است (۳۰). اندازه گیری های دیگر تشدیدکننده ها حاکی از آن است که Q پایین برای این تشدیدکننده می تواند به استفاده از فرآیند گاز POCL3 برای افزودن ناخالصی تشدیدکننده نسبت داده شود که برای کاهش Q تشدیدکننده پلی سیلیکون زیر آلاییده کاشت یون یا آلاییده های در جا مشاهده شده است (۳۲).

اتلاف انکر ممکن است  $Q$  را محدود کند. با این وجود،  $Q$  از ۸۰۰۰ به اندازه کافی برای دست آوردن فیلتر میان گذر انتخابی با تلفات جای گزینی حداقل کافی می باشد.

در بررسی واقعی فیلترها،  $R_{Q2}$  یا با تطبیق شبکه به بار مناسب یا با مقاومت فیزیکی با مقدار  $i_x$  به صورت موازی با گره خروجی فراهم می شود که  $i_x$  را به ولتاژ تبدیل می کند که می تواند به بار مدار بعد بافر شود. به صورت متناوب، ردیابی ترانس رزیستور می تواند از طریق یک آمپلیفایر تبدیل op-amp با استفاده از مقاومت ورودی با مقدار  $R_{Q2}$  به کار گرفته شود.

#### A. بررسی فیلتر میکرومکانیکی و ارزیابی مدل

طیف اندازه گیری شده برای فیلتر مکانیکی  $\mu$  دو تشیدیدکننده ۷,۸۱ مگاهرتز پایانه در شکل ۱۴ نشان داده شده است (منحنی یکسره). پهنهای باند این فیلتر ۱۸ کیلوهرتز است که به مقدار طرح بسیار نزدیک می باشد. تلفات جایگزینی تنها ۱,۸ dB است که برای فیلتر میان گذر با درصد پهنهای باند ۲۳٪ تاثیر گذار است (Q<sub>fltr</sub> = 435) و می تواند به  $Q$  بالا از تشیدیدکننده مکانیکی  $\mu$  نسبت داده شود. ویژگی های فیلتر مکانیکی  $\mu$  اندازه گیری شده و طراحی شده در جدول II خلاصه شده است. شایان ذکر است که اگرچه طرح تحلیلی به دنبال مقاومت های پایان 19.6-kΩ در اندازه گیری واقعی استفاده شدند تا عقب ماندن فاز را کاهش دهند که توسط ظرفیت خازنی پارازتیک سطح برد منجر شده است.

علاوه بر واکنش فرکانس اندازه گیری شده، شکل ۱۴ نیز نشان دهنده ی طیف شبیه سازی شده (خط نقطه چین) است که از مدار معادل استفاده می کند که در شکل ۱۱ با مقادیر المان های ناشی از ستون شیه سازی شده جدول III استفاده می کند و در جدول III خلاصه شده است. این شبیه سازی ها به دنبال تکرار ویژگی های فرکانس اندازه گیری شده در میان گذر می باشند. به همین دلیل، شامل ظرفیت خازنی پارازتیک موازی  $C_{Pi} = 100 fF$  در  $R_{Qi}$  گره های ورودی و خروجی است (شکل ۱) تا پارازتیک سطح برد را مدل سازی کند که با مقاومت های پایان تعامل دارند و ارتعاش میان گذر افزوده را ایجاد می کند. با این حال، باید توجه شود که تنظیم های کمی برای

بدست آوردن درجه تطابق لازم بود. بویژه، توجه داشته باشید که جاگیری فاصله هدف A1۳۰۰ مورد استفاده قرار نگرفت تا ستون شبیه سازی در جدول II یا مفادیر در جدول III را تولید کند. بلکه، جاگیری فاصله بزرگتر از A1۹۸۵ استفاده شد تا حذف در باریکه تشیدیکننده را در نظر گیرد که از میدان الکتریکی بین باریکه  $V_P$  باریکه n دوپ شده و الکترود نوع n القا شده است. این مقدار جایابی فاصله به صورت نیمه تجربی توسط تطبیق طرح های اندازه گیری شده تشیدیکننده  $d_0$  در برابر  $V_P$  با شبیه سازی بر اساس (۱۲) با استفاده از  $f_0$  و k به عنوان پارامترهای مناسب انجام شد.

علاوه بر این، همانطور که به صورت بولد در جدول II نشان داده شده است، موقعیت تزویج کننده  $l_c$  برای تطبیق پهنهای باند تنظیم شد، و تشیدیکننده Q و مقاومت پایان فیلتر  $R_{Qi}$  تنظیم شد تا تلفات جای گزینی را تطبیق دهد. بویژه، میزان  $R_{Qi}$  مورد نیاز برای تطبیق تلفات جای گزینی شبیه سازی شده و ریپل میان گذر ۱۴.۵ kΩ ۱۲.۲ kΩ مورد استفاده برای اندازه گیری.

تنظیم  $l_c$  غیرمعقولانه نیست، از آنجاییکه باریکه تزویج کننده پهنهای محدود  $0.75 \mu\text{m}$  را دارد و موقعیت تزویج کننده دقیق ضرورتا مرکز باریکه تزویج کننده نیست بلکه می تواند هر جایی در راستای پهنهای محدود باشد. علاوه، حرکت پیچشی باریکه تزویج کننده می تواند تزویج کننده مکانیکی واقعی را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین، موثر را تغییر می دهد. تنظیم در Q در جدول II ممکن می باشد از آنجاییکه تعداد کمی از تشیدیکننده Q کمتر از ۸۰۰۰ اندازه گیری شده در شکل ۴ را نشان دادند. انحراف معیار کم در  $R_{Qi}$  نیز نباید هشداردهنده باشد، که به دلیل عدم قطعیت در فاصله حقیقی برای این فرآیند می باشد.

توجه داشته باشید که اگرچه شبیه سازی منطبق با اندازه گیری در میان گذر است، در انتقال به باند توقف منحرف می باشد. بویژه، قطب های اتلاف منحنی توسط نظریه در بخش IV مدلسازی نشدنده که به طور مناسب عامل شکل فیلتر را بهبود می بخشد. قطب های اتلاف در شکل ۱۴ از فعالیت ظرفیت  $C_{P(fd)}$  (شکل ۱) همانند معرفی قطب

های اتلاف از ظرفیت خازن در طرح فیلتر کریستال نبود (۲۶). در آزمایش حاضر،  $C_{P(fd)}$  المان پارازیتیک است، یعنی قطب های اتلاف سهوا معرفی شده اند. برای ادغام کامل فیلترها که در آن مکانیک  $\mu$  و مدارها در کنار هم بر روی یک تراشه ایجاد می شود، ظرفیت پارازیک کوچک تر است. در این مورد ، ظرفیت خازن  $C_{P(fd)}$  feedthrough می تواند به صورت هدف دار برای فیلتر طراحی شود اگر قطب اتلاف مطلوب باشد.

### B. تزویج کننده سرعت پایین

استراتژی تزویج کننده سرعت پایین که در بخش ۱۷ مورد بحث قرار گرفت با اندازه گیری پهنهای باند فیلترها بررسی شد که به عنوان تابعی از موقعیت فنر تزویج کننده در راستای طول باریکه تشید کننده عمل می کند. شکل ۱۵ (الف) و (ب) ویژگی های فرکانس اندازه گیری شده برای دو فیلتر را مقایسه می کند که یکی از آن ها در  $y_c = 4.08 \mu\text{m}$  کوپل شد تا به  $(0.53)v_{\max}$  تزویج کننده برسد و دیگری در  $y_c = 10 \mu\text{m}$  می باشد تا به سرعت تزویج کننده پایین تر  $v_c = (0.12)v_{\max}$  بررسید. پهنهای باند فیلتر با تغییر موقعیت تزویج کننده تغییر می کند. بویژه، فیلتر کوپل شده درصد پهنهای باند  $23.0\%$  را نشان می دهد که کوچک تر از  $2.5\%$  از  $(0.12)v_{\max}$  است که با مورد مخالف آن کوپل شده و کاربرد تزویج کننده سرعت پایین را برای پیاده سازی  $(0.53)v_{\max}$  لازم است که با فلیتر کوپل شده در شکل ۱۵ (الف) برای بررسی بدون تراشه بسیار بزرگ بود که خازن پارازیک نسبتاً بزرگ تاخیرهای فازی مخرب باند عبوری را معرفی می کند. بنابراین، تنها طیف پایان نیافته نشان داده شده است و پهنهای باند به عنوان طیف فرکانس بین پیک های حالت در نظر گرفته می شود. پهنهای باند پایان یافته واقعی بزرگ تر از این خواهد بود. بعلاوه، تفاوت در فرکانس مرکزی دو طیف نشات می گیرد زیرا مقدار  $V_P$  برای اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفت شکل ۱۵ (الف).

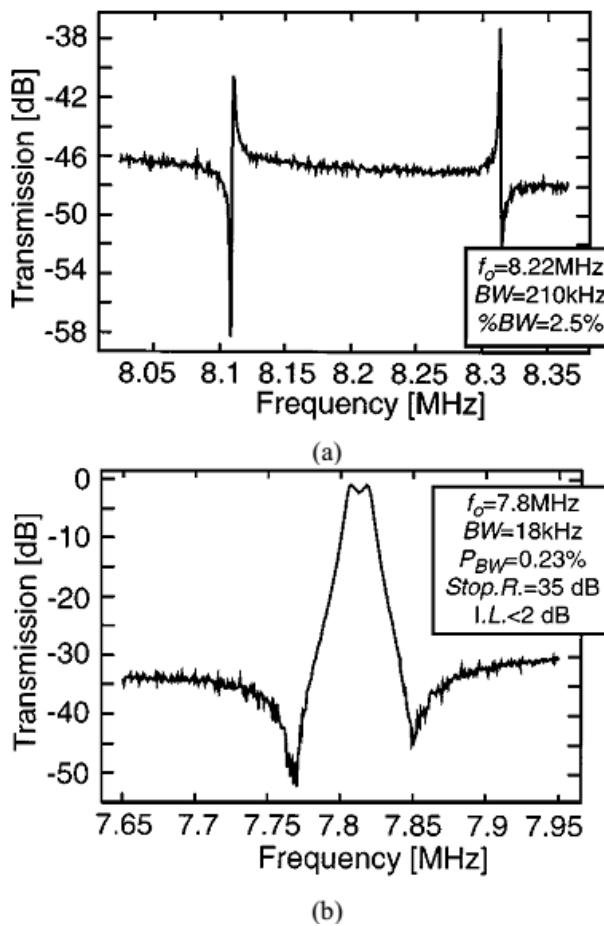
### C. میزان سازی باند عبوری

اگرچه تحمل طبیق شان نسبتا خوب است، فناوری های ساخت مسطح تحمل نسبتا ضعیفی نشان می دهد. برای مثال، خازن تجمعی سازی شده در فناورهای CMOS اغلب تا ۲٪ تطبیق می یابند اما مقادیر اصلی آن ها از مقادیر طراحی شده تا ۲۰٪ منحرف شده اند (۳۳). از دیدگاه میکرومکانیکی، فرکانس های تشدید واقعی می تواند از مقادیر طراحی شده شان با چند درصد منحرف می شود به اندازه ۳٪ در دانشگاه میشیگان می باشد. چنین انحراف فرکانسی به دلیل تعداد پدیده های مرتبط به فرآیند مانند واریانس پهنهای  $W$  می باشد که به دلیل زدودن با لایه زیرین، ضخامت  $h$  به دلیل عدم تجانس میزان فیلم دپازیشن و فشار باقیمانده در فیلم دیپازیت شده می باشد. با فناوری های IC دو وجهی، این واریانس ها در محدوده کوچک می باشد، بنابراین تحمل های تطبیق فرکانس تشدیدکننده به تشدیدکننده نسبتا خوب است که به ترتیب ۴٪ می باشد.

از دیدگاه فیلتر، فرض اینکه تشدیدکننده یکسان مورد استفاده قرار می گیرند، موارد فوق نشان می دهد که باند عبور فیلتر باید قابل تکرار باشد، حداقل برای طرح های  $Q_{\text{fltr}}$  پایین. با این وجود، تحمل درست باعث می شود فرکانس های مرکزی به طور معنادار از مقادیر طراحی شده منحرف شوند. به علاوه، برای فیلترها با  $Q_{\text{fltr}}$  بالا، هر عدم تطابق کوچک در فرکانس تشدیدکننده می تواند منجر به اعوج باند عبور می شود. بنابراین، برای اکثریت برنامه کاربردی، برخی از انواع تریم کردن و تیونیگ مورد نیاز است تا شکل و موقعیت باند عبور را بدست آورد.

جدول III مقادیر المان های مدار فیلتر مکانیکی  $\mu$  HF

Parameter	Value	Units
Coupling Location, $l_c$	4.48	$\mu\text{m}$
$C_{o1}=C_{o2}$	7.14	fF
$l_{x1}=l_{x2}$	$5.66 \times 10^{-13}$	H
$c_{x1}=c_{x2}$	0.000734	F
$r_{x1}=r_{x2}$	$4.62 \times 10^{-9}$	$\Omega$
$c_{s12a}=c_{s12b}$	-0.0121	F
$c_{s12c}$	0.00882	F
$\eta_{e1}=\eta_{e2}$	$1.20 \times 10^{-6}$	C/m
$\eta_{c12}=\eta_{c21}$	7.08	C/m



شکل ۱۵. ویژگی های فرکانس برای (الف)  $(0.53)v_{\max}$  و (ب)  $(0.12)v_{\max}$  فیلتر کوپل شده،

که در فشار 70-mTorr اندازه گیری شده است.

همانطور که توسط (۳) نشان داده شده است، میزانی از میزان سازی فرکانس کنترل شده ولتاژ از طریق تنظیم ولتاژ

بايس  $dc V_F$  می باشد. شکل ۱۶ نشان دهنده ی طرح فرکانس در برابر  $\mu$  برای تشدیدکننده دو سرگیر

دار در مشخصات جدول II می شود. در اینجا، طیف تیونینگ ۷۳۰ فراهم شده است. همانطور که از

(۱۲)-(۱۵) مشاهده می شود، طیف تیونینگ به طرح تشدیدکننده بستگی دارد که با فضائیگری کاهش می یابد و

سختی فراینده را کاهش می دهد.

برای تصحیح باندعبور فیلتر میکرومکانیکی از تشدیدکننده غیرمنطبق، ولتاژ  $V_{\Delta f}$  در شکل ۱ متغیر است تا

فرکانس تشدید تشدیدکننده ۱ را تنظیم کند تا زمانی که با تشدیدکننده ۲ منطبق شود که در آن اعوام باندعبور

حذف می شود. از جدول ۱۲، ولتاژ تیونینگ  $V_{\Delta f}$  از ۷۰،۱۲ برای بدست آوردن در جدول ۱۴ مورد نیاز بود. اگرچه در این طرح مورد استفاده نبود، الکترودهای تیونینگ مجزا می توانست در راستای الکترود ۰/۰ از هر تشدیدکننده معرفی شود تا تابع تیونینگ فرکانس از ۰/۰ را دیکاپل کند.

به منظور اهداف عملی، بسته به اینکه چه قدر خوب تغییر فرآیند می تواند کنترل شود، طیف تیونینگ فرکانس فعال شده ممکن است برای همه موارد کافی نباشد. این برای سیستم های قابل حمل درست است که به طور کلی با ولتاژ تامین پایین عمل می کند (زیر ۳۷) که جای کمی برای واریانس  $V_P$  دارد، حداقل به اندازه کافی نیست تا تحمل واقعی به اندازه ۳٪ را تصحیح کند. برای این منظور، فناوری های تریم کردن جایگزین بررسی می شوند زمانی که با تیونینگ فعال شده تجمیع می شوند، و باید بتوانند طیفی از تنظیم های فرکانس دقیق را مقدرو سازند (۳۲).

#### D. محدوده پویایی عاری از تداخلگر

به دنبال اندازه گیری SFDR خارج از باند برای فیلتر مکانیکی  $\mu$ ، شکل ۱۷ طرحی از قدرت خروجی  $P_0$  در برابر قدرت ورودی  $P_i$  برای تشدیدکننده مکانیکی  $\mu$  پلی سیلیکان ۸,۷۶ مگاهرتزی در مجموعه ای با مقاومت  $R_p = 3050 \Omega$ , ارائه می دهد که داده های طراحی و عملیاتی نیز ارائه شده است. قدرت خروجی هم به سیگنال ورودی درون باندی در  $f_0 = 8.76 \text{ MHz}$  و سیگنال دو تنی خارج از باند با تن هایی در فاصله ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوهertz از  $f_0$  می باشد همانطور که در  $P_{0, IM3}$  و  $P_{0, fund}$  نشان داده شده است. شایان ذکر است که این طرح ها از تشدیدکننده تکی، یک پرتی (در برابر فیلتر پایانه) اندازه گیری شدند و بنابراین خروجی با ابزار اندازه گیری منطبق نبود (تحلیل کننده طیف). این فقدان تطبیق منجر به تلفات جای گزینی بیشتری نسبت به فیلتر تطبیق داده شده می شود اما نقطه شنود ورودی ترتیب سوم (IIP3) مبتنی بر این داده ها را معتبر نمی سازد. بویژه، از نیروی ورودی  $IM3$  تولید شده توسط ترادیسنده ورودی غیرخطی می شود و تابعی از تطبیق خروجی

نیست. (در واقع، محور  $X$  شکل ۱۷ به عنوان نیروی سرعت بهتر از الکتریکی باشد). بنابراین، علاوه‌غم فقدان تطبیق خروجی، IIP3 می‌تواند از شکل ۱۷ استخراج شود و  $-1,3 \text{ dBm}$  مشاهده می‌شود.

باز هم، از آنجاییکه  $\text{IIP3}_{\text{tab}}$  تابعی از قدرت سرعت ورودی است، داده‌های شکل ۱۷ می‌تواند به فیلتر پایانه مناسبی بسط داده شود که به واسطه تطبیق جابجایی ناشی از قدرت ورودی الکتریکی می‌باشد. از آنجاییکه سرعت منطبق با

جريان از طریق مدار معادل تشدیدکننده است،  $\bar{P_i} = P_0$  در برابر فیلتر پایانه مناسبی است که از تشدیدکننده

$8,76 \text{ مگاهرتز}$  استفاده می‌کند که در بالا توصیف شد و می‌تواند با تغییر محور  $\bar{P_i}$  بدست آید طوری که مقادیر

برای فیلتر با جریان‌های تشدیدکننده یکسان تولیدی توسط  $\bar{P_i}$  یکسان است که برای تشدیدکننده منفرد در

شکل ۱۷ می‌باشد. این می‌تواند با معادله زیر انجام شود.

$$P_{i, \text{fltr}} = \left( \frac{2(R_{Qi}R_x)}{(R_x + R_p)} \right) P_{i, \text{res}} \quad (39)$$

که

$P_{i, \text{res}}$  و  $P_{i, \text{fltr}}$  مقیاس‌های نیروی ورودی برای فیلتر و طرح تشدیدکننده می‌باشد. با استفاده از (۳۹)، با فرض اینکه فیلتر پهنای باند  $36 \text{ کیلوهرتز}$  در  $8,76 \text{ مگاهرتز}$  می‌باشد که از تشدیدکننده و بايس در شکل ۱۷ با  $R_{Qi} = 10 \text{ k}\Omega$  استفاده می‌کند، پس همه‌ی منحنی‌ها را به سمت بالا تغییر می‌دهد تا تلفات جای گزینی  $\text{dBZ}$  را در شکل ۱۴ منعکس کند که در شکل ۱۸ نیز نشان داده شده است. نقطه  $\text{IIP3}_{\text{fltr}}$  برای این فیلتر قیاسی اکنون  $5,1 \text{ dBm}$  است.

SFDR خارج از باند (با تن  $200$  و  $400$  کیلوهرتز از فرکانس مرکزی فیلتر) می‌تواند از طریق معادله زیر بیان شود

(۳۱)

$$\text{SFDR} = \frac{2}{3}(\text{IIP3} - N_{oi}) - \text{SNR}_{\min} \quad (40)$$

که همه‌ی مقادیر به دسیبل هستند، باید به صورت نسبت سیگنال به نویز مینمم باشد و  $N_{\text{oi}}$  قدرت نویز اشاره شده ورودی است که برای فیلتر به صورت زیر داده شده است

$$N_{\text{oi}} = N_{\text{RQ}} + IL + 10 \log B \quad (41)$$

که  $N_{\text{RQ}} = -174 \text{ dBm}$  قدرت نویز دمایی ارائه شده توسط  $\text{RQ}$  به بار تطبیق داده شده است،  $IL$  تلفات جایگزینی فیلتر، و  $B$  پهنه‌ای بایند فیلتر است. توجه داشته باشید که نویز مرتبط با حرکت Brownian از ساختار فیلتر مکانیکی  $R_x^{\text{s}}$  مدلسازی شده است (۱۰) و در مولفه  $IL$  در (۴۱) در بر گرفته شده است. برای  $IL = 2 \text{ dB}$  و  $\text{SNR}_{\text{min}} = 10 \text{ dB}$

## محدوده فرکانس قابل کاربرد

.VII

محدوده فرکانس نهایی تشدیدکننده میکرومکانیکی بسیار مورد توجه است و موضوع مورد بررسی می‌باشد. از نقطه نظر هندسی، محدوده فرکانس تشدیدکننده میکرومکانیکی می‌تواند به محدوده گیگاهرتز گسترش یابد. برای مثال، ابعاد تشدیدکننده باریکه دوسرگیردار مورد نیاز برای بدست آوردن فرکانس  $1 \text{ GHz}$  تقریباً برابر است با  $h = 2 \mu\text{m}$  و  $L_r \approx 4 \mu\text{m}$ ,  $W_r = 2 \mu\text{m}$  مورد استفاده قرار گیرد. این فرکانس می‌تواند توسط باریکه‌های طولانی تر در حالات بالاتر بدست آید. بنابراین، طبق پیش‌بینی تحلیلی و اجزا محدود، فرکانس‌ها در محدوده گیگاهرتز به صورت هندسی ممکن می‌باشند.

با این وجود، هندسه تنها یکی از چند مورد، مورد توجه است. محدوده فرکانس کاربردی از تشدیدکننده‌های میکرومکانیکی تابعی از چندین عامل می‌باشد که شامل موارد زیر است:

۱. عامل کیفیت، که ممکن است با فرکانس برای موارد داده شده تغییر کند که به مکانیزم اتلاف انرژی وابسته بر

فرکانس بستگی دارد (۲۸)،

۲. تشدیدکننده حرکتی  $R_{\text{Qi}}$  (به شکل ۱۱ رجوع کنید) که باید کم شود تا به امپدانس  $R_x$  اجازه دهد که با دیگر ترانسیور‌های دیگر تطبیق یابد و انحراف باند عبور را به دلیل پارازیک کاهش دهد (۱۴)، (۳۴)، (۳۵)،

۳. تحمل تطبیقی و محض از فرکانس های تشیدکننده که هر دو تابعی از تکنولوژی ساخت و استراتژی های ترمیم یا تنظیم می باشد (۳۲)،

۴. پایداری فرکانس تشید در برابر تغییرات دما، بارگیری جرم (برای مثال با مولکول های آلوده (۳۶)، افزایش سن و دیگر پدیده های محیطی.

هر یک از پدیده های فوق تحت مطالعه و بررسی می باشد. بویژه، با فرض اینکه خلا کافی می تواند بدست آید، عامل کیفیت نهایی بر نوع مواد و حتی فرآیند تولید بستگی خواهد داشت. برای مثال، سختیو آسیب سطح در طول ساخت ممکن است نقشی در محدود کردن عامل کیفیت ایفا کند. در واقع، نتایج اولیه که عامل کیفیت را در ساختارهای پلی سیلیکان دوب منبع boron مقایسه می کند در برابر دوب های کاشتی، نشان می دهد که مورد دوم ترتیبی از بزرگی بالاتر  $Q$  در فرکانس های نزدیک  $10 \text{ MHz}$  را دارد. دیگر مکانیزم اتلاف که ممکن است با افزایش فرکانس مهم تر باشد، اتلاف زیرساخت از طریق انکر باشد. تونینگ متوازن بیشتر می تواند این مکانیزم را بهبود بخشد.

از منظر طرح فیلتر، محدوده فرکانس عملی توسط تزویج الکترومکانیکی محدود شده است. بویژه، تزویج الکترومکانیکی میزان  $R_{Qi}$  مورد نیاز را تعیین می کند تا فیلتر را پایانی کند و بنابراین، نیازهای تطبیق، قابلیت کنترل قدرت و آسیب پذیری خازن پارازیک موازی انحراف میان گذر را نشان می دهد. برای حل نیازهای تطبیق امپدانس امروزی،  $R_x$  کوچک مورد نیاز است که از (۲۴) میزان کوچک  $R_x$  را در تشیدکننده های فیلتر داده شده ضروری می سازد. از (۱۸)، این به راحتی با کاهش جایابی فاصله الکترود به تشیدکننده بدست می آید،

محدوده همپوشانی الکترود به تشیدکننده را افزایش می دهد. برای اهداف عملی،  $A_0$  با طول کلی باریکه محدود شده است (که به استفاده در تشیدکننده را افزایش می دهد. برای اهداف عملی،  $A_0$  با طول کلی باریکه محدود شده است (که به نوبه خود با  $f_0$  اعمال می شود) و  $V_P$  توسط تامین نیروی در دسترنس یا توسط بالاترین ولتاژ قابل دست یابی از طریق پمپ شارژ در فناوری مدار مورد استفاده محدود می شود. کاهش فضایابی فاصله الکترود به تشیدکننده، شاید  $A_{1300}$  باشد نه  $A_{200}$ ، و استفاده از دوب متفاوت برای تشیدکننده و الکترود (برای مثال تشیدکننده نوع  $R_x$ ، الکترود نوع  $n$ ) برای جلوگیری از افزایش فاصله مبتنی بر تخلیه ممکن است موثرترین روش ها برای کاهش

باشد. برای فیلتر شکل ۱۳، فضایابی فاصله  $d_0 = 276 \text{ \AA}$  به استفاده از تشدید کننده پایانه  $1-k\Omega$  با  $V_P = 5 \text{ V}$ . کمک می کند.

از آنجاییکه فضایابی فاصله برای فیلتر HF فوق توسط ضخامت اکسیده تعريف شده است، می تواند بسیار کوچک باشد، و به ترتیب ده تا صدها انگستروم باشد. به این دلیل، فضایابی فاصله حداقل توسط محدودیت های فرآیند تعیین نمی شود بلکه توسط طیف دینامیک و خطی بودن تعیین می گردد. بویژه، برای بزرگی جابجایی داده شده، کاهش در فضایابی فاصله  $d_0$  منجر به افزایش در غیرخطی بودن مبدل خازن می شود. این می تواند در عبارتی برای انحراف غیرخطی بودن مشاهده شود. عبارت مشابه برای بزرگی مولقه نیروی درون باندی در  $\omega_0$  از مدولاسیون داخلی مرتبه سوم از دو تداخلگر خارج از بند در  $\omega_1 = \omega_0 + \Delta\omega$  ناشی می شود و  $\omega_2 = \omega_0 + 2\Delta\omega$  می تواند با در نظر گرفتن غیرخطی بودن در مبدل خازن ورودی بدست آید. با فرض اینکه جابجایی تشدید کننده به اندازه کافی کوچک است که سختی غیرخطی بودن می تواند نادیده گرفته شود، چنین مشتقی می دهد

$$F_{IM_3} = V_i^3 \cdot \left\{ \frac{1}{4} \frac{(\varepsilon_0 A_0)^2}{d_0^5} \frac{V_P}{k_{\text{ref}}^{\text{eff}}} [2\Theta_1 + \Theta_2] + \frac{3}{4} \frac{(\varepsilon_0 A_0)^3}{d_0^8} \frac{V_P^3}{k_{\text{ref}}^2} \Theta_1 [\Theta_1 + 2\Theta_2] + \frac{3}{2} \frac{(\varepsilon_0 A_0)^4}{d_0^{11}} \frac{V_P^5}{k_{\text{ref}}^3} \Theta_1^2 \Theta_2 \right\} \quad (42)$$

where  $\Theta_1 = \Theta(\omega_1)$ ,  $\Theta_2 = \Theta(\omega_2)$ , and

$$\Theta(\omega) = \frac{1}{|1 - (\omega/\omega_{u3 \text{ dB}})^2 + j\omega/(Q\omega_{u3 \text{ dB}})|} \quad (43)$$

که  $\omega_{u3dB} = \omega_0 + B/2$  فرکانس 3dB در لبه بالایی میان گذر فیلتر است. برای تشدید کننده در مجموعه IP3=  $R_p = 3050 \Omega$  شکل ۱۷، (۴۲) و (۴۳) ترکیب شده اند تا را پیش بینی کند که به ارزش اندازه گیری شده نزدیک است. برای پارامترهای مورد استفاده در مثال فیلتر در شکل ۱۸، (۴۰)-

(۴۲) می دهد  $SFDR = 78 \text{ dB}$ ,  $IIP3 = 5.3 \text{ dBm}$  - که به مقادیر استخراج شده/اندازه گیری شده نزدیک است.

معادله (۲) نشان می دهد که مولفه نیروی مدولاسیون داخلی می تواند با افزایش فضایابی فاصله الکترود به تشدید کننده  $d_0$  و سختی تشدید کننده مجتمع موثر  $k_{\text{reff}}$  کاهش یابد در جالیکه فاصله همپوشانی شده الکترود به تشدید کننده  $A_0$  و بایاس  $dc$  به کار گرفته شده را کاهش می دهد. متاسفانه، همانطور که در شکل (۱۸) و (۲۴) مشاهده شد، این تنظیمات نیز میزان نیاز تشدید کننده پایانه  $R_{Qi}$  را افزایش می دهد. بنابراین، برای طراحی فیلتر این کار، تبادلی بین خطی بودن و توانایی تطبیق امپدانس کم وجود دارد. اگرچه، امپدانس کم در فرکانس های IF نیاز نیست، اما در RF در مسیر انتقال مورد نیاز است. با این حال، حتی کاهش  $d_0$  برای حفظ  $R_{Qi}$  کم، (۴۲) پیش می کند که محدوده پویایی خوبی در فرکانس های بالاتر وجود دارد. برای مثال، برای پهنای باند 200-kHz فرضی، فیلتر مکانیکی  $R_{Qi} = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $\mu = 2 \text{ MHz}$  با  $V_P = 6 \text{ V}$  وجود دارد و با استفاده از تشدید کننده  $d_0$  برای  $\{Q = 8000, L_r = 15.2 \text{ }\mu\text{m}, W_r = 8 \text{ }\mu\text{m}, W_e = 12.2 \text{ }\mu\text{m}, h = 2 \text{ }\mu\text{m}, d_0 = 203 \text{ A}, k_{\text{reff}} = 64152 \text{ N/m, and } R_r = 186 \text{ }\Omega$  و معادلات طراحی شده در بخش III و IV می دهد  $IIP3 = 12 \text{ dBm}$  و  $SFDR = 78 \text{ dB}$ .

از دیدگاه وسیع تر، خطی بودن فوق در برابر تبادل امپدانس منجر به محدودیت کنترل قدرت می شود. برخی از روش های موثر برای افزایش قابلیت کنترل قدرت از فیلترهای میکرومکانیکی شامل پیکربندی مبدل جایگزین (برای مثل مبدل خازن خطی، مبدل پیزوالکتریک) و راه حل های در سطح سیستم (برای مثال موازی سازی فیلترهای میکرومکانیکی) می باشد که هر دو موضوع تحقیق کنونی هستند.

## نتیجه گیری VII

فیلترهای میکروماشینی سطح، پلی سیلیکان، فیلتر های میان گذر مکانیکی  $U$  با  $Q$  بالا در محدوده HF طراحی، ساخته و بررسی شده اند و محدودیت های طراحی ویژه ای ایجاد شده است که به دلیل کوچک سازی تشدید کننده و عوامل فر می باشد. بویژه، جرم باریکه تزویج با تشدید کننده هایی در مقیاس خرد قابل مقایسه است، بنابراین اثر

بارگیری جرم در این حوزه شدت می‌یابد. با عدم حضور روش طراحی مناسب، چنین بارگیری جرم می‌تواند تغییرات فرکانس مرکزی و انحراف در میان گذر فیلتر ایجاد کند. برای سرکوب این تاثیر، فنرهای تزویج کننده ربع طول موج مورد استفاده قرار می‌گیرند اما این‌ها محدودیت‌هایی بر مقادیر سختی کاپلر اعمال می‌کند که پهنای باند درصد قابل دست‌یابی با فیلترهای میکرومکانیکی را با استفاده از هندسه سخت محدود می‌سازد. روش جدید بر مبنای تزویج سرعت پایین معرفی شد و کاهش محدودیت‌های پهنای باند درصد را نشان داد و منجر به درک فیلترهای مکانیکی  $\mu$  با  $Q$  بالا شد.

عملکرد  $Q$  بالا هم برای تشدید کننده  $\mu$  و هم فیلترها در محدوده HF نشان داده شد که منجر به تلفات جای گزینی در فیلترهای میکرومکانیکی پهنای باند درصد کوچک می‌شود. انحراف میان عبور منجر شده با تحمل فرآیند مسطح محدود از طریق قابلیت کشش فرکانس کنترل شده با ولتاژ کاهش یافت که از سختی الکتریکی موثر ناشی می‌شود که به سختی مکانیکی باریکه تشدید کننده می‌افزاید. چنین روش‌های تیونینگ و تنظیم فرکانس مهم است تا بتواند فرکانس‌های VHF و UHF بالاتر را در خود جای دهد.

#### REFERENCES

- [1] H. Khorramabadi and P. R. Gray, "High-frequency CMOS continuous-time filters," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. SC-19, pp. 939–948, Dec. 1984.
- [2] R. A. Sykes, W. L. Smith, and W. J. Spencer, "Monolithic crystal filters," in *1967 IEEE Int. Conv. Rec. pt. II*, Mar. 20–23, pp. 78–93.
- [3] R. C. Rennick, "An equivalent circuit approach to the design and analysis of monolithic crystal filters," *IEEE Trans. Sonic Ultrason.*, vol. SU-20, pp. 347–354, Oct. 1973.
- [4] C. K. Campbell, *Surface Acoustic Wave Devices for Mobile Wireless Communications*. New York, NY: Academic, 1998.
- [5] A. A. Abidi, "Direct-conversion radio transceivers for digital communications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 30, pp. 1399–1410, Dec. 1995.
- [6] J. C. Rudell, J.-J. Ou, T. B. Cho, G. Chien, F. Brianti, J. A. Weldon, and P. R. Gray, "A 1.9-GHz wide-band IF double conversion CMOS receiver for cordless telephone applications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 32, pp. 2071–2088, Dec. 1997.
- [7] D. H. Shen, C.-M. Hwang, B. B. Lusignan, and B. A. Wooley, "A 900-MHz RF front-end with integrated discrete-time filtering," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 31, pp. 1945–1954, Dec. 1996.
- [8] R. T. Howe and R. S. Muller, "Resonant microbridge vapor sensor," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. ED-33, pp. 499–506, 1986.
- [9] W. C. Tang, T.-C. H. Nguyen, and R. T. Howe, "Laterally driven polysilicon resonant microstructures," *Sensors Actuators*, vol. 20, pp. 25–32, 1989.

- [10] C. T.-C. Nguyen and R. T. Howe, "An integrated CMOS micromechanical resonator high-*Q* oscillator," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 34, pp. 440–445, Apr. 1999.
- [11] ———, "Microresonator frequency control and stabilization using an integrated micro oven," in *Dig. Tech. Papers 7th Int. Conf. Solid-State Sensors and Actuators (Transducers '93)*, Yokohama, Japan, June 7–10, 1993, pp. 1040–1043.
- [12] C. T.-C. Nguyen, "Frequency-selective MEMS for miniaturized low-power communication devices," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, vol. 47, no. 8, pp. 1486–1503, Aug. 1999.
- [13] C. T.-C. Nguyen, L. P. B. Katehi, and G. M. Rebeiz, "Micromachined devices for wireless communications," *Proc. IEEE*, vol. 86, pp. 1756–1768, Aug. 1998.
- [14] K. Wang and C. T.-C. Nguyen, "High-order micromechanical electronic filters," in *Proc. 1997 IEEE Int. Micro Electro Mechanical Systems Workshop*, Nagoya, Japan, Jan. 26–30, 1997, pp. 25–30.
- [15] B. E. Boser and R. T. Howe, "Surface micromachined accelerometers," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 31, pp. 366–375, Mar. 1996.
- [16] N. Yazdi, F. Ayazi, and K. Najafi, "Micromachined inertial sensors," *Proc. IEEE*, vol. 86, pp. 1640–1659, Aug. 1998.
- [17] S. Bouwstra and B. Geijsselaers, "On the resonance frequencies of microbridges," in *Dig. Tech. Papers 6th Int. Conf. Solid-State Sensors and Actuators*, San Francisco, CA, June 24–27, 1991, pp. 538–542.
- [18] Q. Meng, M. Mehregany, and R. L. Mullen, "Theoretical modelling of microfabricated beams with elastically restrained supports," *J. Microelectromech. Syst.*, vol. 2, no. 3, pp. 128–137, Sept. 1993.
- [19] W. E. Newell, "Miniaturization of tuning forks," *Science*, vol. 161, pp. 1320–1326, Sept. 1968.
- [20] R. A. Johnson, *Mechanical Filters in Electronics*. New York, NY: Wiley, 1983.
- [21] H. Nathanson, W. E. Newell, R. A. Wickstrom, and J. R. Davis Jr., "The resonant gate transistor," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. ED-14, pp. 117–133, Mar. 1967.
- [22] H. A. C. Tilmans, "Equivalent circuit representation of electro-mechanical transducers: I. Lumped-parameter systems," *J. Micromech. Microeng.*, vol. 6, pp. 157–176, 1996.
- [23] H. A. C. Tilmans and R. Legtenberg, "Electrostatically driven vacuum-encapsulated polysilicon resonators: Part II. Theory and performance," *Sensors and Actuators*, vol. A45, pp. 67–84, 1995.
- [24] A. I. Zverev, *Handbook of Filter Synthesis*. New York: Wiley, 1967.
- [25] M. Konno and H. Nakamura, "Equivalent electrical network for the transversely vibrating uniform bar," *J. Acoust. Soc. Amer.*, vol. 38, pp. 614–622, Oct. 1965.
- [26] M. S. Lee, "Polyolithic crystal filters with loss poles at finite frequencies," in *Proc. 1975 IEEE Int. Symp. Circuits and Syst.*, Apr. 21–23, 1975, pp. 297–300.
- [27] G. T. Mulhern, D. S. Soane, and R. T. Howe, "Supercritical carbon dioxide drying of microstructures," in *Proc. 7th Int. Conf. Solid-State Sensors and Actuators (Transducers '93)*, Yokohama, Japan, June 1993, pp. 296–299.
- [28] V. B. Braginsky, V. P. Mitrofanov, and V. I. Panov, *Systems with Small Dissipation*. Chicago, IL: Univ. Chicago Press, 1985.
- [29] C. H. Mastrangelo and C. H. Hsu, "Mechanical stability and adhesion of microstructures under capillary forces—Part I: Basic theory," *J. Microelectromech. Syst.*, vol. 2, no. 1, pp. 33–43, 1993.
- [30] C. T.-C. Nguyen and R. T. Howe, "Quality factor control for micromechanical resonators," in *Tech. Dig. IEEE Int. Electron Devices Meeting*, San Francisco, CA, Dec. 14–16, 1992, pp. 505–508.
- [31] B. Razavi, *RF Microelectronics*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1998.
- [32] K. Wang, A.-C. Wong, W.-T. Hsu, and C. T.-C. Nguyen, "Frequency-trimming and *Q*-factor enhancement of micromechanical resonators via localized filament annealing," in *Dig. Tech. Papers 1997 Int. Conf. Solid-State Sensors and Actuators*, Chicago, IL, June 16–19, 1997, pp. 109–112.
- [33] R. Gregorian and G. C. Temes, *Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing*. New York: Wiley, 1986.
- [34] F. D. Bannon III and C. T.-C. Nguyen, "High frequency microelectromechanical IF filters," in *Tech. Dig. 1996 IEEE Electron Devices Meeting*, San Francisco, CA, Dec. 8–11, 1996, pp. 773–776.
- [35] J. R. Clark, A.-C. Wong, and C. T.-C. Nguyen, "Parallel-resonator HF micromechanical bandpass filters," in *Dig. Tech. Papers 1997 Int. Conf. Solid-State Sensors and Actuators*, Chicago, IL, June 16–19, 1997, pp. 1161–1164.



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

✓ لیست مقالات ترجمه شده

✓ لیست مقالات ترجمه شده رایگان

✓ لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI

سایت ترجمه فا؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معترض خارجی